

"Express Mail" mailing label number EV 327 136 328 US

Date of Deposit 3/12/04

Our File No. 9281-4755
Client Reference No. N US03022

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)
Kiyoshi Sato)
Serial No. To Be Assigned)
Filing Date: Herewith)
For: Thin Film Magnetic Head Having)
Toroidal Coil and Manufacturing)
Method of the Same)

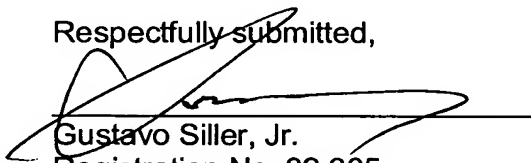
**SUBMISSION OF CERTIFIED COPIES
OF PRIORITY DOCUMENTS**

Mail Stop Patent Application
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Transmitted herewith is a certified copy of priority document Japanese Patent Application Nos. 2003-069330 filed on March 14, 2003 and 2003-293390 filed on August 14, 2003 for the above-named U.S. application.

Respectfully submitted,


Gustavo Siller, Jr.
Registration No. 32,305
Attorney for Applicant
Customer Number 00757

BRINKS HOFER GILSON & LIONE
P.O. BOX 10395
CHICAGO, ILLINOIS 60610
(312) 321-4200



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 1 4 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 6 9 3 3 0
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 6 9 3 3 0]

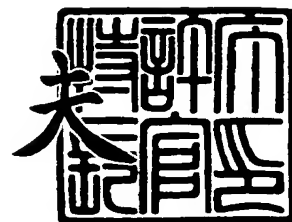
出 願 人 アルプス電気株式会社
Applicant(s):



2 0 0 3 年 8 月 1 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 6 6 0 9 0

【書類名】 特許願

【整理番号】 031017AL

【提出日】 平成15年 3月14日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 5/31

【発明の名称】 薄膜磁気ヘッドおよびその製造方法

【請求項の数】 18

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号 アルプス電気株式会社
社内

【氏名】 佐藤 清

【特許出願人】

【識別番号】 000010098

【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

【代表者】 片岡 政隆

【代理人】

【識別番号】 100085453

【弁理士】

【氏名又は名称】 野▲崎▼ 照夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100121049

【弁理士】

【氏名又は名称】 三輪 正義

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 041070

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1
【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 薄膜磁気ヘッドおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 記録媒体との対向面からハイト方向に延びて形成された下部コア層と、前記下部コア層の上方に形成され、前記対向面でのトラック幅方向の寸法でトラック幅 T_w を規定する磁極層と、前記磁極層を軸として巻回形成されたトロイダルコイル層とを有し、

前記トロイダルコイル層は、前記下部コア層と磁極層間に形成された複数の第 1 コイル片と、前記磁極層上に形成された複数の第 2 コイル片とが接続されて成り、

前記第 1 コイル片の上面は、前記第 2 コイル片との接続面を除いて、絶縁層で覆われているとともに、前記第 1 コイル片の接続面は上方に持ち上げられて、前記接続面が前記絶縁層の上面から露出し、

前記第 2 コイル片が前記第 1 コイル片の接続面上に接して形成されることを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

【請求項 2】 トラック幅方向の中心からトラック幅方向に離れた位置での下部コア層上に持ち上げ層が設けられ、前記第 1 コイル片の一部は前記持ち上げ層上に乗り、乗った位置での前記第 1 コイル片の上面の一部が前記絶縁層の上面から露出し、この露出面が前記接続面となる請求項 1 記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 3】 前記持ち上げ層の上面は平坦化面であり、この平坦化面上に乗った第 1 コイル片の上面の少なくとも一部が接続面となる請求項 2 記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 4】 前記第 1 コイル片は前記平坦化面の途中まで形成される請求項 3 記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 5】 前記持ち上げ層の表面は湾曲面であり、この湾曲面上に乗った第 1 コイル片の上面の一部が接続面となる請求項 2 記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 6】 前記第 1 コイル片は、前記湾曲面の途中まで形成される請求項 5 記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 7】 前記絶縁層の上面、及び前記第 1 コイル片の接続面は同一の

平坦化面である請求項 1 ないし 6 のいずれかに記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 8】 前記持ち上げ層は複数本の前記第 1 コイル片の下を横断している請求項 2 ないし 7 のいずれかに記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 9】 前記持ち上げ層は、個々の第 1 コイル片の下にそれぞれ設けられている請求項 2 ないし 7 のいずれかに記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 10】 以下の工程を有することを特徴とする薄膜磁気ヘッドの製造方法。

(a) 記録媒体との対向面からハイト方向に下部コア層を延ばして形成する工程と、

(b) 前記下部コア層のトラック幅方向の中心からトラック幅方向に離れた位置での下部コア層上に持ち上げ層を形成する工程と、

(c) 複数本の第 1 コイル片を、ハイト方向に間隔を空けて、前記下部コア層の上方から前記持ち上げ層上にかけて形成する工程と、

(d) コイル絶縁層を第 1 コイル片間及び第 1 コイル片上に形成する工程と、

(f) 前記コイル絶縁層の上面を削って平坦化面に形成するとともに、前記持ち上げ層の上面に形成された第 1 コイル片の一部を前記コイル絶縁層の上面から露出させて、露出面を形成する工程と、

(g) 前記コイル絶縁層上に磁極層を形成した後、前記磁極層の上方に第 2 コイル片を複数本形成し、このとき、前記第 2 コイル片の端部を前記第 1 コイル片に形成された前記露出面上に直接接触させ、前記第 1 コイル片と第 2 コイル片とから成るトロイダルコイル層を形成する工程。

【請求項 11】 前記 (b) 工程で、前記持ち上げ層の上面を平坦化面に形成し、前記 (f) 工程で、この平坦化面上に乗った前記第 1 コイル片の一部が前記露出面となるように研削加工を施す請求項 10 記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【請求項 12】 前記 (b) 工程で、前記第 1 コイル片を前記平坦化面の途中まで形成する請求項 11 記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【請求項 13】 前記 (b) 工程で、前記持ち上げ層の上面を湾曲面に形成し、前記 (f) 工程で、この湾曲面上に乗った前記第 1 コイル片の一部が前記露

出面となるように研削加工を施す請求項 10 記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【請求項 14】 前記 (b) 工程で、前記第 1 コイル片を前記湾曲面の途中まで形成する請求項 13 記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【請求項 15】 前記 (f) 工程で、前記コイル絶縁層の上面と前記第 1 コイル片に形成された前記露出面とを、同一の平坦化面に形成する請求項 10 ないし 14 のいずれかに記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【請求項 16】 前記 (f) 工程で、前記絶縁層と前記露出面とを、CMP により同一の平坦化面に形成する請求項 15 記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 17】 前記 (c) 工程で、複数本の第 1 コイル片の下を持ち上げ層が横断するように、前記 (b) 工程で、前記持ち上げ層を帯状に形成する請求項 10 ないし 16 のいずれかに記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 18】 前記 (c) 工程で、個々の前記第 1 コイル片の下にそれぞれ持ち上げ層が形成されるように、前記 (b) 工程で、前記持ち上げ層を個々に分断形成する請求項 10 ないし 16 のいずれかに記載の薄膜磁気ヘッド。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、磁極層の周囲をトロイダル状に巻回されたコイル構造を有する薄膜磁気ヘッドに係り、特に第 1 コイル片と第 2 コイル片とをより簡単に接続でき、且つ接続抵抗を小さくできるとともに磁気飽和し難く、磁化効率の向上が可能な薄膜磁気ヘッドに関する。

【0002】

【従来の技術】

以下に示す特許文献 1 には、インダクティブヘッド（記録ヘッド）を構成する磁極層の周囲をコイル片がトロイダル状に巻回された構成のトロイダル薄膜磁気ヘッドが開示されている。この薄膜磁気ヘッドの断面形状を図 17 に書き写した。

【0003】

図 17 に示すように、基板 2 上に、例えば絶縁層 3 を介して前記磁極層 4 の下

方に形成された第 1 コイル片 5 が形成され、前記第 1 コイル片 5 の上に絶縁層 6、磁極層 4 が形成されている。この磁極層 4 の両側面から上面にかけて絶縁層 7 が形成されており、この絶縁層 7 の上面から前記第 1 コイル片 5 の上面にかけ、スルーホール 1 2 を介して第 2 コイル片 8 が形成されている。前記第 1 コイル片 5 と、前記第 2 コイル片 8 とは接続部 9 で接した状態で電氣的に接続されている。また、前記接続部 9 の側方には絶縁層 1 0 が形成され、前記第 2 コイル片 8 の上面から前記絶縁層 7 の上面にかけて絶縁層 1 1 が形成されている。

【0 0 0 4】

一方、以下に示す特許文献 2, 3, 4 にも、インダクティブヘッド（記録ヘッド）を構成する磁極層の周囲をトロイダル状に巻回されたコイル片を有するトロイダル薄膜磁気ヘッドが開示されている。これらの薄膜磁気ヘッドでも、磁極層の下方に形成された第 1 コイル片と、前記磁極層の上方に形成された第 2 コイル片とが接した状態で電氣的に接続されている。これらの薄膜磁気ヘッドでは、下部コア層の表面に凹部が形成されており、前記下部コア層の表面から前記凹部の底面にかけて、前記磁極層の下方に形成された第 1 コイル片が形成されている。前記第 1 コイル片の中央領域は前記凹部の上面から側面にかけて形成されており、前記第 1 コイル片の側端部は前記下部コア層の表面に形成されている。従って、前記第 1 コイル片の両側端部は前記中央領域よりも上方に位置するように構成されている。そして、前記第 1 コイル片の両側端部と前記第 2 コイル片の側端部とが接した状態で電氣的に接続されている。

【0 0 0 5】

【特許文献 1】

特開平 5 - 2 5 0 6 3 6 号公報

【特許文献 2】

特開昭 5 0 - 1 4 7 9 1 6 号公報

【特許文献 3】

特開昭 5 0 - 1 4 5 7 9 1 7 号公報

【特許文献 4】

実開昭 6 1 - 1 3 2 5 1 6 号公報

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、前記特許文献1に開示された薄膜磁気ヘッド1では、前記第1コイル片5と前記第2コイル片8とを接続させるために、前記絶縁層7にスルーホール12を形成する必要がある。このスルーホール12はエッチング加工により行うことが開示されているが、スルーホール12を正確な位置や深さで高精度で形成するのは困難であるため、前記第1コイル片5と前記第2コイル片8との接続が不良になり、またコイル抵抗が増大するという問題があった。すなわち、前記スルーホール12が形成される位置がずれたり、スルーホール12の大きさが小さくなることで、前記第1コイル片5と前記第2コイル片8との接続面積が小さくなり、電気抵抗が大きくなる。その結果、前記接続部9附近で熱が発生しやすく、薄膜磁気ヘッドの内部が高温になる。薄膜磁気ヘッド内部が高温になると、コア層や絶縁層との熱膨張係数の差により、薄膜磁気ヘッドの記録媒体との対向面が基板（スライダ）よりも前方に突出し、この結果、前記薄膜磁気ヘッドが記録媒体上に衝突しやすくなり、前記薄膜磁気ヘッドや前記記録媒体に損傷を与えてしまう。

【0007】

また前記スルーホールの形成時に、前記第1コイル片が損傷するといった問題もある。

【0008】

また、前記特許文献1に開示された薄膜磁気ヘッド1では、前記第2コイル片8が斜め下方に傾斜した状態で前記第1コイル片5と接続されているが、この傾斜した部分では、メッキ成長し難いため膜厚が小さくなる。したがって、これによっても電気抵抗の増大や、熱の発生が生じるという問題がある。

【0009】

また前記特許文献2, 3, 4に開示された薄膜磁気ヘッドでは、下部コア層に凹部が形成された構成であるため、前記下部コア層の断面積が小さくなり、これにより磁気飽和しやすいといった問題がある。

【0010】

さらに前記特許文献 2, 3, 4 に開示された薄膜磁気ヘッドでは、特許文献 1 と同様に、第 1 コイル片の前記第 2 コイル片との接続部分では、スルーホールが形成され、前記スルーホールを介して前記第 1 コイル片と第 2 コイル片とが接続されるため、前記第 1 コイル片と第 2 コイル片間の接続不良などによって前記第 1 コイルと第 2 コイル片との接続部附近での電気抵抗が大きくなりやすく熱が生じやすい。またスルーホールを形成して第 1 コイル片と第 2 コイル片とを接続する方法では、前記スルーホールの形成時に前記第 1 コイル片が傷つきやすい。

【0011】

本発明は前記従来課題を解決するものであり、第 1 コイル片と第 2 コイル片との接続をより簡単にでき、且つ接続抵抗を小さくできるとともに磁気飽和し難くし、磁化効率の向上が可能な薄膜磁気ヘッドを提供することを目的としている。

【0012】

【課題を解決するための手段】

本発明における薄膜磁気ヘッドは、記録媒体との対向面からハイト方向に延びて形成された下部コア層と、前記下部コア層の上方に形成され、前記対向面でのトラック幅方向の寸法でトラック幅 T_w を規定する磁極層と、前記磁極層を軸として巻回形成されたトロイダルコイル層とを有し、

前記トロイダルコイル層は、前記下部コア層と磁極層間に形成された複数の第 1 コイル片と、前記磁極層上に形成された複数の第 2 コイル片とが接続されて成り、

前記第 1 コイル片の上面は、前記第 2 コイル片との接続面を除いて、絶縁層で覆われているとともに、前記第 1 コイル片の接続面は上方に持ち上げられて、前記接続面が前記絶縁層の上面から露出し、

前記第 2 コイル片が前記第 1 コイル片の接続面上に接して形成されることを特徴とするものである。

【0013】

本発明における薄膜磁気ヘッドでは、前記第 1 コイル片の上面を覆う絶縁層の上面から前記第 1 コイル片の接続面が露出しており、前記接続面上に前記第 2 コ

イル片が直接接して形成されている。このように本発明では、従来のようにスルーホールなどを設けることなく前記第1コイル片と第2コイル片との接続を簡単に行うことができ、また前記第1コイル片と第2コイル片との接続を確実なものにできる。よって前記第1コイル片と第2コイル片とが接続する部分での電気抵抗を従来よりも小さくでき熱の発生を抑制できる。従って薄膜磁気ヘッドの内部での温度が高温になることを抑制でき薄膜磁気ヘッドの熱膨張量を小さくでき、前記薄膜磁気ヘッド及び記録媒体の損傷を防止できる。

【0014】

また本発明では、トラック幅方向の中心からトラック幅方向に離れた位置での下部コア層上に持ち上げ層が設けられ、前記第1コイル片の一部は前記持ち上げ層上に乗り、乗った位置での前記第1コイル片の上面の一部が前記絶縁層の上面から露出し、この露出面が前記接続面となることが好ましい。

【0015】

前記持ち上げ層は下部コア層とは別体で形成されるものであるため、従来のように前記下部コア層に凹部を設けなくても前記第1コイル片の一部を前記持ち上げ層上に乗せることで、その乗せられた位置での前記第1コイル片の上面の一部を前記絶縁層の上面から簡単に露出させることができる。この形態では、前記第1コイル片の接続面の面積をコントロールしやすく、また前記接続面の周囲を同一の絶縁層で十分な膜厚をもって、第2コイル片との絶縁性を確保しやすい。また、前記下部コア層が磁気飽和し難く、良好な磁化特性を発揮することが可能となる。

【0016】

また、前記持ち上げ層の上面は平坦化面であり、この平坦化面上に乗った第1コイル片の上面の少なくとも一部が接続面となることが好ましい。このように構成すると、前記第1コイル片と前記第2コイル片との接続をさらに良好にすることができる。

【0017】

なお、前記第1コイル片は前記平坦化面の途中まで形成される形態であると、特に前記平坦化面上に十分な膜厚で第1コイル片を形成できる。

【0018】

また本発明では、前記持ち上げ層の表面は湾曲面であり、この湾曲面上に乗った第1コイル片の上面の一部が接続面となる形態であってもよい。かかる場合でも前記第1コイル片は、前記湾曲面の途中まで形成されることが好ましい。

【0019】

また本発明では、前記絶縁層の上面、及び前記第1コイル片の接続面は同一の平坦化面であることが好ましい。このように構成することで前記磁極層を平坦化面上に形成しやすく、トラック幅 T_w を高精度に規制しやすい。また前記第1コイル片と第2コイル片との接続をより確実なものにできる。

【0020】

また前記持ち上げ層は複数本の前記第1コイル片の下を横断していてもよいし、前記持ち上げ層は、個々の第1コイル片の下にそれぞれ設けられている形態であってもよい。

【0021】

また本発明の薄膜磁気ヘッドの製造方法は、以下の工程を有することを特徴とするものである。

(a) 記録媒体との対向面からハイト方向に下部コア層を延ばして形成する工程と、

(b) 前記下部コア層のトラック幅方向の中心からトラック幅方向に離れた位置での下部コア層上に持ち上げ層を形成する工程と、

(c) 複数本の第1コイル片を、ハイト方向に間隔を空けて、前記下部コア層の上方から前記持ち上げ層上にかけて形成する工程と、

(d) コイル絶縁層を第1コイル片間及び第1コイル片上に形成する工程と、

(f) 前記コイル絶縁層の上面を削って平坦化面に形成するとともに、前記持ち上げ層の上面に形成された第1コイル片の一部を前記コイル絶縁層の上面から露出させて、露出面を形成する工程と、

(g) 前記コイル絶縁層上に磁極層を形成した後、前記磁極層の上方に第2コイル片を複数本形成し、このとき、前記第2コイル片の端部を前記第1コイル片の前記露出面上に直接接触させ、前記第1コイル片と第2コイル片とから成るトロ

イダルコイル層を形成する工程。

【0022】

本発明の薄膜磁気ヘッドの製造方法によれば、前記第1コイル片の上面にコイル絶縁層が形成されていても、前記コイル絶縁層を研磨することにより、前記コイル絶縁層の上面に前記第1コイル片の一部を簡単に露出できる。ここで、この露出面は第2コイル片との接続面となるため、前記第1コイル片と前記第2コイル片とを接続するため、前記コイル絶縁層にスルーホールを形成する工程が必要ない。したがって、前記第2コイル片との接続面となる露出面を容易に、かつ正確な位置に高精度で形成することが可能である。また、前記コイル絶縁層を研磨する際にその削り量を調整することで、前記接続面を、所定の面積で露出させることができるため、前記第1コイル片と前記第2コイル片との接続を良好とすることが可能となり、電気抵抗の増大を抑制することができる。したがって、薄膜磁気ヘッドの内部での温度が高温になることを抑制でき、薄膜磁気ヘッドの熱膨張量を小さくでき、薄膜磁気ヘッドおよび記録媒体の損傷を防止できる。

【0023】

また、前記持ち上げ層は下部コア層とは別体で形成することができるため、従来のように前記下部コア層に凹部を設けなくても前記第1コイル片の一部を前記持ち上げ層上に乗せて形成することで、その乗せられた位置での前記第1コイル片の上面の一部を前記絶縁層の上面から簡単に露出させることができる。したがって、前記第1コイル片の接続面の面積をコントロールしやすく、また前記接続面の周囲を同一の絶縁層で十分な膜厚をもって、第2コイル片との絶縁性を確保しやすい。また、前記下部コア層が磁気飽和し難く、良好な磁化特性を発揮することが可能となる。

【0024】

また、前記(b)工程で、前記持ち上げ層の上面を平坦化面に形成し、前記(f)工程で、この平坦化面上に乗った前記第1コイル片の一部が前記露出面となるように研削加工を施すことが好ましい。

【0025】

このように構成すると、前記第2コイル片との接続面となる前記露出面上に第

2 コイル片を乗せやすく、前記第 1 コイル片 5 5 と前記第 2 コイル片 5 6 との接続をさらに良好にすることができる。

【0026】

また、前記 (b) 工程で、前記第 1 コイル片を前記平坦化面の途中まで形成するものとして構成することができる。

【0027】

このように構成すると、前記平坦化面上に十分な膜厚で第 1 コイル片を形成できる。

【0028】

また、前記 (b) 工程で、前記持ち上げ層の上面を湾曲面に形成し、前記 (f) 工程で、この湾曲面上に乗った前記第 1 コイル片の一部が前記露出面となるように研削加工を施すものとして構成しても良い。

【0029】

この場合、前記 (b) 工程で、前記第 1 コイル片を前記湾曲面の途中まで形成することもできる。

【0030】

また、前記 (f) 工程で、前記コイル絶縁層の上面と前記第 1 コイル片に形成された前記露出面とを、同一の平坦化面に形成することが好ましい。

【0031】

このように構成すると、前記コイル絶縁層 3 6 に形成される磁極層を所定形状で形成しやすく、前記磁極層の記録媒体との対向面での幅寸法で決定されるトラック幅 T_w を高精度に形成できるとともに、前記第 1 コイル片と前記第 2 コイル片との接続を確実に行うことができる

この場合、前記 (f) 工程で、前記絶縁層と前記露出面とを、CMPにより同一の平坦化面に形成することができる。

【0032】

また、前記 (c) 工程で、複数本の第 1 コイル片の下を持ち上げ層が横断するように、前記 (b) 工程で、前記持ち上げ層を帯状に形成するものとして構成しても良いし、または前記 (c) 工程で、個々の前記第 1 コイル片の下にそれぞれ

持ち上げ層が形成されるように、前記（b）工程で、前記持ち上げ層を個々に分断形成するものとして構成しても良い。

【0033】

【発明の実施の形態】

図1は、本発明における第1実施形態の薄膜磁気ヘッド1Aの構造を示す部分縦断面図、図2は図1に示す薄膜磁気ヘッド1Aから隆起層32、保護層60、MRヘッド等を図面上除き、最も記録媒体との対向面側に形成された第1コイル片及び第2コイル片と、これらの層と膜厚方向で対向する各層の構造を記録媒体との対向面側から見た部分正面図、図3は図1に示す薄膜磁気ヘッド1Aのコイル構造を説明するための部分平面図、図4は図1に示す薄膜磁気ヘッド1Aの第1コイル片および前記第1コイル片の下方に形成された持ち上げ層を示す部分断面図、図5は図1に示す薄膜磁気ヘッド1Aの一部の構造を示した部分拡大斜視図である。

【0034】

なお以下では図示X方向をトラック幅方向と呼び、図示Y方向をハイト方向と呼ぶ。また図示Z方向は記録媒体（磁気ディスク）の進行方向である。また薄膜磁気ヘッドの前端面（図1に示す最左面）を「記録媒体との対向面」と呼ぶ。さらに各層において「前端面」とは図1における左側の面を指し「後端面」とは図1における右側の面を指す。

【0035】

また図面を用いて説明する薄膜磁気ヘッド1Aは、記録用ヘッド（インダクティブヘッドとも言う）と再生用ヘッド（MRヘッドとも言う）とが複合された薄膜磁気ヘッドであるが、記録用ヘッドのみで構成された薄膜磁気ヘッドであってもよい。

【0036】

符号20はアルミナチタンカーバイト（ Al_2O_3-TiC ）などで形成された基板であり、前記基板20上に Al_2O_3 層21が形成されている。

【0037】

前記 Al_2O_3 層21上には、NiFe系合金やセンダストなどで形成された

下部シールド層 22 が形成され、前記下部シールド層 22 の上に Al_2O_3 など
で形成された下部ギャップ層 23 が形成されている。

【0038】

前記下部ギャップ層 23 の上の記録媒体との対向面からハイト方向（図示 Y 方向）に所定の長さでスピバルブ型薄膜素子などの GMR 素子に代表される磁気抵抗効果素子 24 が形成され、前記磁気抵抗効果素子 24 のトラック幅方向（図示 X 方向）の両側にはハイト方向（図示 Y 方向）に長く延びる電極層 25 が形成されている。

【0039】

前記磁気抵抗効果素子 24 上及び電極層 25 上には Al_2O_3 など形成された上部ギャップ層 26 が形成され、前記上部ギャップ層 26 上には NiFe 系合金などで形成された上部シールド層 27 が形成されている。

【0040】

前記下部シールド層 22 から前記上部シールド層 27 までを再生用ヘッド（MR ヘッドとも言う）と呼ぶ。

【0041】

図 1 に示すように前記上部シールド層 27 上には、 Al_2O_3 など形成された分離層 28 が形成されている。なお前記上部シールド層 27 及び分離層 28 が設けられておらず、前記上部ギャップ層 26 上に次の下部コア層 29 が設けられていてもよい。かかる場合、前記下部コア層 29 が上部シールド層をも兼ね備える。

【0042】

図 1 では、前記分離層 28 の上に下部コア層 29 が形成されている。前記下部コア層 29 は NiFe 系合金などの磁性材料で形成される。前記下部コア層 29 は記録媒体との対向面からハイト方向（図示 Y 方向）に所定の長さ寸法で形成される。前記下部コア層 29 の後端面 29a よりもハイト方向後方及び前記下部コア層 29 のトラック幅方向（図示 X 方向）における両側には非磁性絶縁材料層 31 が設けられている。図 1 に示すように前記下部コア層 29 及び非磁性絶縁材料層 31 の各層の表面は連続した平坦化面である。

【0043】

前記下部コア層 29 上には記録媒体との対向面からハイト方向（図示 Y 方向）にかけて所定の長さ寸法 L1（図 5 を参照）で形成された隆起層 32 が形成されている。さらに前記隆起層 32 のハイト方向後端面 32a からハイト方向（図示 Y 方向）に所定距離離れた位置にバックギャップ層 33 が前記下部コア層 29 上に形成されている。

【0044】

前記隆起層 32 及びバックギャップ層 33 は磁性材料で形成され、前記下部コア層 29 と同じ材質で形成されてもよいし、別の材質で形成されていてもよい。また前記隆起層 32 及びバックギャップ層 33 は単層であってもよいし多層の積層構造で形成されていてもよい。前記隆起層 32 及びバックギャップ層 33 は前記下部コア層 29 に磁氣的に接続されている。

【0045】

図 1 に示すように、前記隆起層 32 とバックギャップ層 33 間の下部コア層 29 上にはコイル絶縁下地層 34 が形成され、前記コイル絶縁下地層 34 上には、図 3 に示すようにトラック幅方向（図示 X 方向）に延びる複数本の第 1 コイル片 55 がハイト方向に並んで形成されている。

【0046】

前記第 1 コイル片 55 上は A12O3 などの無機絶縁材料で形成されたコイル絶縁層 36 で埋められている。図 1 に示すように前記隆起層 32 の上面、コイル絶縁層 36 の上面、及びバックギャップ層 33 の上面は図 1 に示す基準面 A に沿った連続した平坦化面となっている。

【0047】

図 1 に示すように前記隆起層 32 及びコイル絶縁層 36 の平坦化面上には、前記記録媒体との対向面からハイト方向（図示 Y 方向）に所定の距離離れた位置からハイト方向に向けて Gd 決め層 38 が形成されている。

【0048】

図 1 に示す実施形態では前記 Gd 決め層 38 の前端面 38a は、隆起層 32 上にあり、また前記 Gd 決め層 38 の後端面 38b はコイル絶縁層 36 上にある。

【0049】

また図1に示すように、記録媒体との対向面から前記G d 決め層38の前端面38aまでの隆起層32上、前記G d 決め層38の後端面38bよりハイト方向のコイル絶縁層36上、及び前記バックギャップ層33上に、下から下部磁極層39及びギャップ層40が形成されている。前記下部磁極層39及びギャップ層40はメッキ形成されている。

【0050】

また図1に示すように前記ギャップ層40上及びG d 決め層38上には、上部磁極層41がメッキ形成され、さらに前記上部磁極層41上には上部コア層42がメッキ形成されている。

【0051】

この実施の形態では、前記下部磁極層39、ギャップ層40、上部磁極層41及び上部コア層42の4層で磁極層62が構成されている。なお、前記磁極層62は図1に示すように、下から下部磁極層39、ギャップ層40、上部磁極層41及び上部コア層42の順に積層された4層構造であるものに限定されるものではなく、例えば前記磁極層62が、下から下部磁極層39、ギャップ層40及び上部磁極層41の順に積層された3層構造で構成されるものであっても良い。

【0052】

図1及び図2に示すように前記磁極層62の上面62aからトラック幅方向の両側端面62bにかけて例えばAl₂O₃やSiO₂などの無機絶縁材料や、レジストなどの有機絶縁材料で形成された絶縁層58が形成されている。

【0053】

図1ないし図3に示すように前記絶縁層58の上に、トラック幅方向（図示X方向）からハイト方向（図示Y方向）に延びる複数本の第2コイル片56がハイト方向に並んで形成されている。

【0054】

図2に示すように、前記第1コイル片55の上面55eは前記コイル絶縁層36によって覆われている。しかし、全ての前記上面55eが前記コイル絶縁層36によって覆われているわけではなく、前記第1コイル片55の第2コイル片5

6 との接統面 81 は前記コイル絶縁層 36 の上面 36a と同一の平坦化面で形成される。

【0055】

図2及び図3に示すように、この薄膜磁気ヘッド1Aにおけるトラック幅方向の中心B-Bからトラック幅方向に離れた位置での下部コア層29上には持ち上げ層80が形成される。この持ち上げ層80は所定の幅寸法を有して形成され、また図3や図4のように、各第1コイル片55の下を横断するように帯状で形成される。前記持ち上げ層80は例えばレジストによる有機絶縁材料などの絶縁材料により形成される。

【0056】

前記第1コイル片55は、コイル絶縁下地層34上から前記持ち上げ層80上にかけて形成される。このため前記持ち上げ層80上に形成された第1コイル片55の端部領域55a、55bは中央領域55fに比べて上方に持ち上げられ、前記持ち上げ層80上に乗った前記端部領域55a、55bの一部が前記コイル絶縁層36の上面36aから露出し、この露出面が接統面81となっている。

【0057】

なお図2に示す実施の形態では、前記第1コイル片55の端部領域55a、55bは、前記持ち上げ層80よりもさらに中心B-Bから離れる方向に延出し、前記第1コイル片55のトラック幅方向における端面55c、55dは、前記持ち上げ層80のトラック幅方向の外方に位置するように構成されている。

【0058】

図2に示すように、前記持ち上げ層80は、X-Z平面と平行な方向における断面形状が所定の高さ寸法h1を有した半円形状や半楕円形状で構成されている。このため前記持ち上げ層80の表面は湾曲面となっている。

【0059】

ここで前記高さ寸法h1は、前記コイル絶縁下地層34の上面から前記持ち上げ層80の最も高い位置までの高さ寸法を意味する。

【0060】

前記のように持ち上げ層80は所定の高さ寸法h1を有しているため、図2、

図3および図4に示すように、前記第1コイル層55は前記持ち上げ層80の上に形成されている前記端部領域55a, 55bが、その他の領域部分よりも上方に突出し、前記持ち上げ層80上に乗った位置での第1コイル片55の上面の一部を接続面81として形成することができる。

【0061】

前記接続面81は、前記接続面81以外の第1コイル片55の上面55eを覆う前記コイル絶縁層36の上面36aと同一の平坦化面であることが好ましい。このような平坦化面はCMP技術などによる研削加工によって形成される。図2に示すように、前記第2コイル片56の端部領域56a, 56bは、前記接続面81上に直接接し、電氣的に接続した状態である。すなわち、前記第1コイル片55の一方の端部領域55aは前記接続面81において、前記第2コイル片56の一方の端部領域56aと直接に接した状態で電氣的に接続されている。同様に、前記第1コイル片55の他方の端部領域55bは前記接続面81において、前記第2コイル片56の他方の端部領域56bと直接に接した状態で電氣的に接続されている。

【0062】

また図3に示すように、前記引出し層59は、最後方に形成された前記第2コイル片56よりもハイト方向後方に形成され、最後方に形成された前記第1コイル片55と前記接続面81において直接に接した状態で電氣的に接続されている。

【0063】

このように図1に示す薄膜磁気ヘッド1Aでは、前記磁極層62の膜厚方向の上下で対向する第1コイル片55のトラック幅方向における端部領域55a, 55bと第2コイル片56のトラック幅方向における端部領域56a, 56bとが、前記接続面81で直接に接した状態で電氣的に接続され、トロイダル状のコイル構造57が形成されている。

【0064】

前記薄膜磁気ヘッド1Aでは、前記第1コイル片55と前記第2コイル片56とが、例えば接続層などの介在部材を介さずに、直接に接触した状態で電氣的に

接続されているため、介在部材の電気抵抗が発生しない。また、前記第1コイル片55の端部領域55a、55bの下には持ち上げ層80が形成され、これによって前記端部領域55a、55bが中央領域55fよりも上方に持ち上げるため、第1コイル片55の上面55eに前記コイル絶縁層36が形成されていても、前記コイル絶縁層36をCMPなどにより研磨すれば、前記第2コイル片56との接続面81を簡単に露出でき、前記コイル絶縁層36にスルーホールを形成する工程が必要ない。仮に、前記コイル絶縁層36にスルーホールを形成するものとする、前記スルーホールはエッチング加工により行うことになるが、エッチングでは前記スルーホールを正確な位置や深さで高精度で形成するのは困難であるため、前記スルーホールが形成される位置がずれることによって、前記第1コイル片55と前記第2コイル片56との接続面積が小さくなり、電気抵抗が大きくなり、その結果、前記第1コイル片55と前記第2コイル片56との接続部で熱が発生するという問題が生じる。また前記スルーホールの形成時に前記第1コイル片の端部領域55a、55bに損傷を与えるといった問題もある。

【0065】

これに対し、前記薄膜磁気ヘッド1Aでは、前記接続面81は、持ち上げ層80が形成される位置によって決定されるが、この持ち上げ層80は、レジストによるフォトリソエッチングによって形成することができるため、正確な位置に高精度で形成することが可能である。また、前記コイル絶縁層36をCMP技術などにより研磨する際にその削り量を調整することで、前記接続面81を、所定の面積で露出させることができる。そのため、前記第1コイル片55と前記第2コイル片56との接続を良好とすることが可能となり、電気抵抗の増大を抑制することができる。

【0066】

さらに、前記下部コア層29に凹部を設ける必要がないため、前記下部コア層29の断面積を大きくすることができる。したがって、前記下部コア層29の磁気飽和を抑制することができ、磁化効率の向上を図ることが可能となる。

【0067】

また本実施の形態のように、下部コア層29上に帯状の持ち上げ層81を必要

な部分にのみ設けることで、接続面 81 以外の部分での第 1 コイル片 55 と第 2 コイル片 56 間の絶縁性や第 1 コイル片 55 や磁極層 62 間の絶縁性はもちろんのこと、前記第 1 コイル片 55 の端面 55c, 55d よりも外方領域や各第 1 コイル片 55 間での下部コア層 29 と第 2 コイル片 56 や磁極層 62 との絶縁性も、前記第 1 コイル片 55 の上面 55e を覆うコイル絶縁層 36 により十分な膜厚をもって確保しやすい。

【0068】

また、前記接続面 81 はコイル絶縁層 36 の上面 36a と同一の平坦化面に形成されているため、前記接続面 81 上に第 2 コイル片 56 の端部領域 56a、56b を乗せやすく、前記第 1 コイル片 55 と前記第 2 コイル片 56 との接続を良好にすることができる。したがって、前記第 1 コイル片 55 と前記第 2 コイル片 56 との接触抵抗を更に低く抑えることが可能となる。また前記コイル絶縁層 36 の上面 36a が平坦化面であるので、前記コイル絶縁層 36 上に形成される磁極層 62 を所定形状で形成しやすく、前記磁極層 62 の記録媒体との対向面での幅寸法で決定されるトラック幅 Tw を高精度に形成できる。

【0069】

また前記接続面 81 での面積を大きくして前記第 2 コイル片 56 との接続を良好にするには、少なくとも前記第 1 コイル片 55 の前記持ち上げ層 80 上に乗る位置での端部領域 55a, 55b の幅寸法を中央領域 55f での幅寸法に比べて大きくすることが好ましい。また前記持ち上げ層 80 上に乗る位置での端部領域 55a, 55b の幅寸法を、第 2 コイル片 56 の幅寸法より大きくすることが好ましい。また前記接続面 81 の面積は前記接続面 81 上及びコイル絶縁層 36 上に乗る部分での第 2 コイル片 56 の端部領域 56a、56b の下面 56a1, 56b1 の面積より小さくてもよいが、小さすぎると電気抵抗が高くなってしまうため、前記接続面 81 の面積は、前記接続面 81 上及びコイル絶縁層 36 上に乗る部分での第 2 コイル片 56 の端部領域 56a、56b の下面 56a1, 56b1 の面積の 50%～100% の範囲内であることが好ましい。

【0070】

図 4 に示す実施の形態では、前記持ち上げ層 80 は所定の幅寸法で実質的にハ

イト方向に延びる帯状の形状で構成され、複数本の第1コイル片55の下を横断しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、図6に示すように、持ち上げ層80は複数の持ち上げ片80aからなり、前記持ち上げ片80aは各第1コイル片55の下にそれぞれ設けられ、この各持ち上げ層80aが個々の第1コイル片55の端部領域55a、55bを、それぞれ上方に持ち上げるように構成されていても良い。

【0071】

図7は本発明の第2の実施の形態の薄膜磁気ヘッド1Bを示す部分正面図であり、図2に相当するものである。また、図8は図7に示す薄膜磁気ヘッド1Bの第1コイル片および前記第1コイル片の下方に形成された持ち上げ層を示す部分断面図であり、図4に相当するものである。

【0072】

図7および図8に示す薄膜磁気ヘッド1Bは、図1ないし図5に示す薄膜磁気ヘッド1Aと同様の構造部分を有して構成されている。したがって、図7および図8では、図1ないし図5に示す薄膜磁気ヘッド1Aと同様の構造部分には同様の符号を付して、その詳しい説明を省略する。

【0073】

図7および図8に示すように、前記薄膜磁気ヘッド1Bも、持ち上げ層80が前記下部コア層29の上に形成された前記コイル絶縁層34の上に位置して形成されている。前記持ち上げ層80は、前記第1コイル片55の端部領域55a、55bの下方に、複数の前記第1コイル片55のそれぞれの前記端部領域55a、55bの下を横断するように、記録媒体との対向面からハイト方向に実質的に延びて形成されている。

【0074】

図7に示すように、前記持ち上げ層80は、X-Z平面と平行な方向での断面形状が所定の高さ寸法h1を有した半円形状や半楕円形状で構成されている。ここで前記高さ寸法h1は、前記コイル絶縁層34の上面から前記持ち上げ層80の最も高い位置までの高さ寸法を意味する。

【0075】

図7および図8に示すように、前記薄膜磁気ヘッド1Bは、第1コイル片55のトラック幅方向における端面55c、55dが、持ち上げ層80の上面に位置するように構成されている。すなわち前記第1コイル片55は、トラック幅方向にて持ち上げ層80間に挟まれた位置でのコイル絶縁下地層34上から前記持ち上げ層80の途中にまで延びて形成されている。

【0076】

図7および図8に示すように、前記第1コイル片55の端部領域56a、56bは、前記持ち上げ層80の上に形成されている。この持ち上げ層80は前記したように所定の高さ寸法h1を有しているため、前記第1コイル層55は前記持ち上げ層80の上に形成されている前記端部領域55a、55bが、中央領域55fよりも上方に突出し、持ち上げ層80上に乗った位置での端部領域55a、55bの上面の一部が、前記コイル絶縁層36の上面36aから露出し、その露出面が接続面81となる。図7に示すように、前記接続面81は前記コイル絶縁層36の上面36aと同一の平坦化面に形成されている。

【0077】

前記接続面81上には、前記第2コイル片56の端部領域56a、56bが直接に接触し、前記第1コイル片55と第2コイル片56とが電氣的に接続した状態である。すなわち、前記第1コイル片55の一方の端部領域55aは前記接続面81において、前記第2コイル片56の一方の端部領域56aと直接に接した状態で電氣的に接続されている。同様に、前記第1コイル片55の他方の端部領域55bは前記接続面81において、前記第2コイル片56の他方の端部領域56bと直接に接した状態で電氣的に接続されている。

【0078】

このように構成された前記薄膜磁気ヘッド1Bでも、接続面81を所定面積でコイル絶縁層36の上面36aから露出させることができ、前記第1コイル片55と前記第2コイル片56とを、直接に接触した状態で電氣的に接続できるので、接続層などの介在部材やスルーホールなどを形成する必要がなく、電気抵抗を低くすることができる。

【0079】

また、前記下部コア層 29 に凹部を設ける必要がないため、前記下部コア層 29 の断面積を大きくすることができる。したがって、前記下部コア層 29 の磁気飽和を抑制することができ、磁化効率の向上を図ることが可能となる。

【0080】

また、前記接続面 81 はコイル絶縁層 36 の上面 36a と同一の平坦化面に形成されているため、前記第 2 コイル片 56 の端部領域 56a, 56b を前記接続面 81 上に確実に且つ簡単に導通接続できる。したがって、前記第 1 コイル片 55 と前記第 2 コイル片 56 との接触抵抗を更に低く抑えることが可能となる。また前記コイル絶縁層 36 上に所定形状の磁極層 62 を形成しやすい。

【0081】

また前記第 1 コイル片 55 の端部領域 55a, 55b を図 2 のようにトラック幅方向における持ち上げ層 80 を越えてその外方にまで延出形成せず、図 7 のように前記持ち上げ層 80 の表面の途中までしか形成しないことで、第 1 コイル片 55 の形成時に、持ち上げ層 80 上に乗った部分での前記第 1 コイル片 55 の端部領域 55a, 55b の上面が、中央領域 55f の上面と同じ位相での平坦化面になろうと第 1 コイル片 55 の上面全体が均される現象、いわゆるレベリング効果が生じる。このレベリング効果を抑制でき、前記持ち上げ層 80 上に前記端部領域 55a, 55b を厚い膜厚で形成できる。この結果、前記接続面 81 をコイル絶縁層 36 内に埋没している第 1 コイル片 55 の上面 55e に比べて十分に上方に持ち上げることができ、前記第 1 コイル片 55 の上面 55e と磁極層 62 間の絶縁性などを十分に確保しやすい。

【0082】

図 7 及び図 8 に示す実施の形態では、前記持ち上げ層 80 は所定の幅寸法で実質的にハイト方向に延びる帯状の形状で構成されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、図 9 に示すように、前記持ち上げ層 80 は複数の持ち上げ片 80a によって構成され、この各持ち上げ片 80a が各第 1 コイル片 55 の端部領域 55a, 55b 下にそれぞれ設けられていてもよい。これにより各第 1 コイル片 55 の端部領域 55a, 55b が、個々に設けられた持ち上げ片 80a によって上方に持ち上げられる。

【0083】

図8に示すように、帯状に延びる一体の持ち上げ層80が複数の各第1コイル片55の端部領域55a, 55bの下を横断するように設けられている方が製造を容易化できるが、図9のように、持ち上げ層80を複数の持ち上げ片80aに分断形成しても良い。

【0084】

図10は本発明の第3の実施の形態の薄膜磁気ヘッド1Cを示す部分正面図であり、図2に相当するものである。また、図11は図10に示す薄膜磁気ヘッド1Cの第1コイル片および前記第1コイル片の下方に形成された持ち上げ層を示す部分断面図であり、図4に相当するものである。

【0085】

図10および図11に示す薄膜磁気ヘッド1Cは、図1ないし図5に示す薄膜磁気ヘッド1Aと同様の構造部分を有して構成されている。したがって、図10および図11では、図1ないし図5に示す薄膜磁気ヘッド1Aと同様の構造部分には同様の符号を付して、その詳しい説明を省略する。

【0086】

図10および図11に示すように、前記薄膜磁気ヘッド1Cも、所定の幅寸法を有する帯状の持ち上げ層180が、トラック幅方向の中心B-Bからトラック幅方向に離れた位置での前記コイル絶縁下地層34の上に位置して形成されている。前記持ち上げ層180は、例えばレジストによる有機絶縁材料により形成され、前記第1コイル片55の端部領域55a, 55bの下に、各第1コイル片55を横断するように記録媒体との対向面からハイト方向に実質的に延びて形成されている。

【0087】

図10に示すように、前記持ち上げ層180は、X-Z平面と平行な方向での断面形状が所定の高さ寸法h2を有した略台形状の形状で構成されている。ここで前記高さ寸法h2は、前記コイル絶縁層34の上面から前記持ち上げ層180の最も高い位置までの高さ寸法を意味する。

【0088】

図 10 に示すように、前記持ち上げ層 180 の上面 180 b には平坦化面が形成されている。

【0089】

図 10 および図 11 に示すように、前記第 1 コイル片 55 の端部領域 55 a, 55 b は、前記持ち上げ層 180 の上に形成されており、第 1 コイル片 55 のトラック幅方向における端部 55 c, 55 d が、平坦化された前記上面 180 b の上に位置するように構成されている。すなわち前記第 1 コイル片 55 は、トラック幅方向にて前記持ち上げ層 180 間に挟まれたコイル絶縁下地層 34 上から前記持ち上げ層 180 の上面 180 b の途中にまで形成されている。この持ち上げ層 180 は前記したように所定の高さ寸法 h_2 を有しているため、前記第 1 コイル層 55 は前記持ち上げ層 180 の上に形成されている前記端部領域 55 a, 55 b が、中央領域 55 f よりも上方に突出し、前記持ち上げ層 180 上に乗った部分での前記第 1 コイル片 55 の端部領域 55 a, 55 b 上面の少なくとも一部がコイル絶縁層 36 の上面 36 a から露出した状態になっており、この露出面が接続面 181 となる。

【0090】

前記持ち上げ層 180 の上面 180 b は平坦化面に形成されているため、前記上面 180 b の上に形成される前記第 1 コイル片 55 の端部領域 55 a, 55 b は厚さ寸法 t_1 が大きく形成されやすい。すなわち、前記持ち上げ層 180 の上面 180 b に前記第 1 コイル片 55 は、後記するようにフレームメッキ法により形成されるが、このとき、前記持ち上げ層 180 の上面 180 b が平坦化面に構成されていると、前記第 1 コイル片 55 が図示 Z 方向にメッキ成長しやすくなり、前記膜厚 t_1 を大きくすることが可能になるのである。前記膜厚 t_1 が大きく構成されると、前記接続面 181 の面積を所定面積に画定しやすいとともに、第 1 コイル片 55 と磁極層 62 間のコイル絶縁層 36 の膜厚を厚くできるので、前記第 1 コイル片 55 と磁極層 62 間の絶縁性を良好に保ちやすい。

【0091】

前記接続面 181 は、前記コイル絶縁層 36 の上面 36 a と同一の平坦化面に形成されていることが好ましい。

【0092】

前記接続面 181 上には、前記第 2 コイル片 56 の端部領域 56a, 56b の下面が直接に接触し、前記第 1 コイル片 55 と第 2 コイル片 56 とが電氣的に接続した状態である。すなわち、前記第 1 コイル片 55 の一方の端部領域 55a は前記接続面 181 において、前記第 2 コイル片 56 の一方の端部領域 56a と直接に接した状態で電氣的に接続されている。同様に、前記第 1 コイル片 55 の他方の端部領域 55b は前記接続面 181 において、前記第 2 コイル片 56 の他方の端部領域 56b と直接に接した状態で電氣的に接続されている。

【0093】

このように図 10 及び図 11 に示す薄膜磁気ヘッド 1C では、前記磁極層 62 の膜厚方向の上下で対向する第 1 コイル片 55 のトラック幅方向における端部領域 55a, 55b と第 2 コイル片 56 のトラック幅方向における端部領域 56a, 56b とが、前記接続面 181 で直接に接した状態で電氣的に接続され、トロイダル状のコイル構造 57 が形成されている。

【0094】

このように構成された前記薄膜磁気ヘッド 1C でも、前記接続面 181 をコイル絶縁層 36 の上面 36a から確実に露出させることができ、この接続面 181 上に第 2 コイル片 56 の端部領域 56a, 56b を直接接して形成できるため、接続層などの介在部材やスルーホール形成を必要とせず、第 1 コイル片 55 と第 2 コイル片 56 との接続を確実に且つ簡単なものにできるとともに、電気抵抗を低くすることができる。

【0095】

また、前記下部コア層 29 に凹部を設ける必要がないため、前記下部コア層 29 の断面積を大きくすることができる。したがって、前記下部コア層 29 の磁気飽和を抑制することができ、磁化効率の向上を図ることが可能となる。

【0096】

さらに図 10 及び図 11 のように、下部コア層 29 上に必要な部分にのみ持ち上げ層 180 を設ければよいので、持ち上げ層 180 から外れる位置でのコイル絶縁層 36 の膜厚を厚く形成でき、前記接続面 181 以外における第 1 コイル片

55と第2コイル片56間の絶縁性や、前記第1コイル片55とコイル絶縁層36間の絶縁性を十分に保つことが可能である。

【0097】

また、前記接続面181はコイル絶縁層36の上面36aと同一の平坦化面として形成されるため、前記接続面181上に第2コイル片56の端部領域56a、56bを確実に接合でき、第1コイル片55と第2コイル56との接続を良好なものにできる。また前記コイル絶縁層36上に形成される磁極層62を所定形状に形成しやすく、前記磁極層62の記録媒体との対向面での幅で決められるトラック幅Twを精度良く形成できる。

【0098】

図11に示す実施の形態では、前記持ち上げ層180は所定の幅寸法で実質的にハイト方向に延びる帯状の形状で構成されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、図12に示すように、前記持ち上げ層180は複数の持ち上げ片180aによって分断形成され、前記持ち上げ片180aが各第1コイル片55の端部領域55a、55bを、それぞれ上方に持ち上げるように構成されていても良い。図11に示すように、帯状に延びる一体の持ち上げ層180が複数の各第1コイル片55の端部領域55a、55bの下を横断するように形成されていると、前記持ち上げ層180の製造が容易になる。

【0099】

また、図12のように前記持ち上げ層180を個々の持ち上げ片180aに分断し、各持ち上げ片180a上にそれぞれの第1コイル片55の端部領域55a、55bを形成すると、前記持ち上げ片180a間に空間ができるので、この部分にコイル絶縁層36を厚い膜厚で形成でき、隣り合う第1コイル片55の端部領域55a、55b間の絶縁性を良好に保つことができる。

【0100】

また図10ないし図11のように、前記持ち上げ層180の上面180aが平坦化されたものであると、この上面180aに前記第1コイル片55の端部領域55a、55bを乗り上げ形成しやすく、また前記端部領域55a、55bでの膜厚t1を所定膜厚で形成しやすい。ただし、前記第1コイル片55の両側端面

55c, 55dは前記持ち上げ層180の上面180bの途中にあることが好ましく、仮に図2のように前記両側端面55c, 55dをトラック幅方向にて前記持ち上げ層180の外方にまで延出形成すると、レベリング効果が発生しやすく、前記持ち上げ層180の上面180aに乘る部分での持ち上げ層180の膜厚 t_1 が小さくなりやすい。よって前記レベリング効果を抑制するには、前記第1コイル片55を前記持ち上げ層180の上面180bの途中までしか形成しないようにすることが好ましい。

【0101】

なお上記のレベリング効果は特に上面180bが平坦化面となっている図10のような断面が略台形状や略矩形状である持ち上げ層180の上面180bに第1コイル片55を乗り上げ形成した場合の方が、表面が湾曲面である図2のような持ち上げ層80上に第1コイル片55を乗り上げ形成する場合に比べて大きいものと考えられる。このため表面が湾曲面である持ち上げ層80を用いる場合は、図2のように前記持ち上げ層80を越えて、その外方にまで前記第1コイル片55を延出形成してもレベリング効果は、持ち上げ層180を用い前記持ち上げ層180を超えてその外方にまで第1コイル片55を延出形成する場合に比べて小さいものと考えられる。

【0102】

図13は本発明の第4の実施の形態の薄膜磁気ヘッド1Dを示す部分正面図であり、図2に相当するものである。また、図14は図13に示す薄膜磁気ヘッド1Dの第1コイル片および前記第1コイル片の下方に形成された持ち上げ層を示す部分断面図であり、図4に相当するものである。

【0103】

図13および図14に示す薄膜磁気ヘッド1Dは、図1ないし図5に示す薄膜磁気ヘッド1Aと同様の構造部分を有して構成されている。したがって、図13および図14では、図1ないし図5に示す薄膜磁気ヘッド1Aと同様の構造部分には同様の符号を付して、その詳しい説明を省略する。

【0104】

図13および図14に示すように、前記薄膜磁気ヘッド1Dも、持ち上げ層2

80が中心B-Bからトラック幅方向に離れた位置での前記下部コア層29の上に形成された前記コイル絶縁層34の上に位置して形成されている。前記持ち上げ層280は、例えばレジストによる有機絶縁材料などの絶縁材料により形成された複数の持ち上げ片280aによって構成されている。前記持ち上げ片280aは、各第1コイル片55の端部領域55a, 55bの下に、それぞれ設けられている。

【0105】

図13および図14に示すように、前記持ち上げ片280aは、断面形状が所定の高さ寸法h3を有した半円球形状で構成されている。ここで前記高さ寸法h3は、前記コイル絶縁層34の上面から前記突出片280aの最も高い位置までの高さ寸法を意味する。

【0106】

図15は、前記第1コイル片55および前記突出片280aを示す部分拡大平面図である。図13および図14に示す薄膜磁気ヘッド1Dでは前記持ち上げ片280aのX-Y平面と平行な方向での断面は略円状であり、図15に示すように、前記持ち上げ片280aの直径寸法dは、前記第1コイル片55の端部領域55a, 55bの幅寸法w1よりも大きく形成されている。

【0107】

図13ないし図15に示すように、前記薄膜磁気ヘッド1Dは、第1コイル片55のトラック幅方向における端部55c, 55dが、持ち上げ片280aの表面280b上に位置するように構成されている。

【0108】

図13または図14に示すように、前記第1コイル片55の端部領域56a, 56bの少なくとも一部は、前記持ち上げ片280aの上に形成されている。この持ち上げ片280aは前記したように所定の高さ寸法h3を有しているため、前記第1コイル片55は前記持ち上げ片280aの上に形成されている前記端部領域55a, 55bが、前記第1コイル片55の中央領域55fに比べて上方に突出し、前記持ち上げ片280a上に乗った位置での前記第1コイル片55の端部領域55a, 55bの一部が前記コイル絶縁層36の上面36aから露出し、

この露出面が接続面 281 となる。

【0109】

前記接続面 281 は、前記コイル絶縁層 36 の上面 36a と同一の平坦化面に形成されることが好ましい。

【0110】

前記接続面 281 上には、前記第 2 コイル片 56 の端部領域 56a, 56b が直接に接触し、前記第 1 コイル片 55 と第 2 コイル片 56 とが電氣的に接続した状態である。すなわち、前記第 1 コイル片 55 の一方の端部領域 55a は前記接続面 281 において、前記第 2 コイル片 56 の一方の端部領域 56a と直接に接した状態で電氣的に接続されている。同様に、前記第 1 コイル片 55 の他方の端部領域 55b は前記接続面 281 において、前記第 2 コイル片 56 の他方の端部領域 56b と直接に接した状態で電氣的に接続されている。

【0111】

このように構成された前記薄膜磁気ヘッド 1D でも、コイル絶縁層 36 の上面 36a から前記接続面 281 を確実に露出させることができ、接続層などの介在部材やスルーホール形成などが必要なくとも、前記第 2 コイル片 56 の端部領域 56a, 56b を前記接続面 281 上に接合するだけで、前記第 1 コイル片 55 と第 2 コイル片 56 とを良好に接続させることができる。

【0112】

また、前記下部コア層 29 に凹部を設ける必要がないため、前記下部コア層 29 の断面積を大きくすることができる。したがって、前記下部コア層 29 の磁気飽和を抑制することができ、磁化効率の向上を図ることが可能となる。

【0113】

また、前記接続面 281 は、コイル絶縁層 36 の上面 36a と同一の平坦化面で形成されるので、前記接続面 281 上に確実に第 2 コイル片 56 の端部領域 56a, 56b を接合させることができるとともに、前記コイル絶縁層 36 上に所定形状で磁極層 62 を形成でき、前記磁極層 62 の記録媒体との対向面でのトラック幅方向の幅で決められるトラック幅 Tw を高精度に形成することができる。

【0114】

図13ないし図15に示す実施の形態では、前記持ち上げ片280aの直径寸法dは、前記第1コイル片55の端部領域55a、55bの幅寸法w1よりも小さく形成されている。ただし本発明はこれに限定されるものではなく、図16に示すように、前記持ち上げ片280aの直径寸法dが、前記第1コイル片55の端部領域55a、55bの幅寸法w1よりも大きく形成されるものであっても良い。

【0115】

なお図15のように、端部領域55a、55bの幅寸法w1より前記持ち上げ片280aの直径dを小さくすると、前記持ち上げ片280a上に乗る端部領域55a、55bは少なくなるため、前記コイル絶縁層36の上面36aから露出する接続面281の面積も減少してしまう。このため、前記接続面281の面積を大きくして、第2コイル片56と第1コイル片55との接続を確実なものにするには、図16のように持ち上げ片280aの直径dが前記端部領域55a、55bの幅寸法W1よりも大きい方がよい。ただしレベリング効果を少なくするには、図15のように端部領域55a、55bの幅寸法W1より前記持ち上げ片280aの直径dを小さくする方が好ましいと考えられる。

【0116】

また図1ないし図15において説明してきた前記持ち上げ層のX-Z平面と平行な平面での断面形状や、X-Y平面と平行な平面での断面形状は、これらの図に示すものに限るものではなく、他の形状であってもかまわない。また前記持ち上げ層の材質については、レジストなどの有機絶縁材料や Al_2O_3 や SiO_2 などの無機絶縁材料を使用できる。特に図2などの持ち上げ層80のように表面を湾曲面とする場合には、レジストなどの有機絶縁材料を用いるとよい。かかる場合、レジストを塗布した後、パターンニングし、さらに熱処理を加えることで、前記持ち上げ層80の表面を湾曲面にできる。また図10の持ち上げ層180のように、上面180aに平坦化面を有する形状とする場合には、無機絶縁材料を使用する方がよい。

【0117】

前記薄膜磁気ヘッド1Aの製造方法を、図17ないし図26によって説明する

。なお図 1 に示す下部コア層 29 から第 2 コイル片 56 までの各層の形成方法について説明する。また図 17 ないし図 26 に示す製造工程図は製造途中の薄膜磁気ヘッドの縦断面図（すなわち図示 Y-Z 平面と平行な平面から切断した断面図）である。

【0118】

図 17 に示す工程で、まず NiFe 系合金等からなる下部コア層 29 をメッキ形成し、 Al_2O_3 などの非磁性絶縁材料層 31 を形成した後、CMP 技術等を用いて前記下部コア層 29 表面及び非磁性絶縁材料層 31 表面を研磨加工する。

【0119】

図 18 に示す工程では、前記下部コア層 29 表面及び非磁性絶縁材料層 31 表面に Al_2O_3 、 SiO_2 などのコイル絶縁下地層 34 をスパッタ等で形成する。

【0120】

次に図 19 に示す工程を行う。ここで図 19 は、図 17 や図 18 とは別の部分を切断して示した薄膜磁気ヘッドの部分縦断面図である。図 19 は図 2 に示す持ち上げ層 80 の幅方向（図示 X 方向）における寸法を 2 分する C-C 線に沿って切断した状態を、Y-Z 平面と平行な方向から見た部分縦断面図である。

【0121】

図 19 に示すように、前記コイル下地絶縁層 34 の上面に、所定の高さ寸法 h_1 を有する図 2 および図 4 に示す持ち上げ層 80 を、レジストなどの絶縁材料により形成する。この持ち上げ層 80 は、フォトエッチング法によって形成することができる。

【0122】

前記持ち上げ層 80 は、図 2 での矢視では、半円形状や半楕円形状で構成されるため、前記持ち上げ層 80 の表面は湾曲面となる。

【0123】

次に、図 20、および図 21 に示す工程を行う。ここで、図 21 は図 20 とは別の部分を切断して示した薄膜磁気ヘッドの部分縦断面図であり、図 19 に相当する位置での部分縦断面図である。

【0124】

図20に示す工程では、前記コイル絶縁下地層34上に複数本の第1コイル片55をパターン形成する。複数の前記第1コイル片55をそれぞれハイト方向に並べて形成する。このとき、図21に示すように、前記持ち上げ層80上に前記第1コイル片55の端部領域55a、55bの少なくとも一部が乗り上げるように形成する。この際、図4に示すように、前記第1コイル片55の端部領域55a、55bの一部が前記持ち上げ層80のトラック幅方向の外方に位置するように形成する。ここで、前記第1コイル片55はCuなどの非磁性導電材料でメッキ形成する。

【0125】

前記第1コイル片55は、コイル絶縁下地層34上から前記持ち上げ層80上にかけて形成されるため、図2に示すように前記持ち上げ層80上に形成された第1コイル片55の端部領域55a、55bは中央領域55fに比べて上方に持ち上げられる。

【0126】

図22に示す工程では、前記コイル絶縁下地層34上にレジスト層75を塗布し、このレジスト層75に露光現像により穴部75a、75bを形成する。前記穴部75aは、記録媒体との対向面から前記第1コイル片55のうち最も前記対向面寄りの前記第1コイル片55の前端面付近まで、前記穴部75bは、前記下部コア層29の基端部付近に設けられ、各穴部75a、75bから露出するコイル絶縁下地層34をエッチングで除去した後、前記穴部75a内から露出する前記下部コア層29上に隆起層32をメッキ形成し、同じ工程時に、前記穴部75b内から露出する前記下部コア層29の基端部上にバックギャップ層33をメッキ形成する。前記隆起層32および前記バックギャップ層33は磁性材料で形成され、前記下部コア層29と同じ材料で形成しても良いし、別の材料で形成しても良い。前記隆起層32および前記バックギャップ層33は単層で形成しても良いし、多層の積層構造で形成しても良い。前記隆起層32及びバックギャップ層33と下部コア層29間にはコイル絶縁下地層34は無く、これらの層は磁氣的に接続された状態になっている。

【0 1 2 7】

次に、前記隆起層 3 2 上及びバックギャップ層 3 3 上、第 1 コイル片 5 5 の上面 5 5 e 上を、A l 2 O 3 などの無機絶縁材料でスパッタなどで覆い、コイル絶縁層 3 6 を形成する。

【0 1 2 8】

なお図 1 9 工程後、図 2 2 工程で示す隆起層 3 2 およびバックギャップ層 3 3 を形成し、その後図 2 0 に示す工程で第 1 コイル片 5 5 を形成してもよい。

【0 1 2 9】

次に、図 2 3、図 2 4 に示す工程を行う。ここで、図 2 4 は図 2 3 の状態を記録媒体との対抗面側から見た正面図であり、図 2 と同様の位置から見たものである。図 2 3 および図 2 4 に示すように、図示 D-D 線まで前記コイル絶縁層 3 6、前記隆起層 3 2、前記バックギャップ層 3 3 を、図示 X-Y 方向と並行な方向から CMP 技術等を用いて削り込む。このとき、ある程度、前記の各層を削り込むと、前記持ち上げ層 8 0 上に乗り上げ形成された第 1 コイル片 5 5 の端部領域 5 5 a、5 5 b の一部が前記コイル絶縁層 3 6 の上面 3 6 a から露出する。前記端部領域 5 5、5 5 b の露出面は第 2 コイル片 5 6 との接続面 8 1 であり、前記削り量によって前記接続面 8 1 の露出面積を規制することができる。前記接続面 8 1 の露出面積が所定面積になったらその時点で前記研削加工を止める。前記削り込みを CMP により行くと、削り込み量の制御が容易である。削り込みを終了した時点を示したのが図 2 5 および図 2 6 である。ここで、図 2 6 は図 2 4 と同様の正面図である。

【0 1 3 0】

図 2 5 および図 2 6 では隆起層 3 2 の上面、コイル絶縁層 3 6 の上面、バックギャップ層 3 3 の上面が基準面 A に沿った平坦化面として形成される。そして図 2 6 に示すように第 1 コイル片 5 5 は、前記接続面 8 1 以外の部分が前記コイル絶縁層 3 6 内に完全に埋められた状態になっている。また、図 2 4 および図 2 6 に示すように、前記接続面 8 1 も前記コイル絶縁層 3 6 の上面と同じ前記平坦化面に形成することが好ましい。なお前記研削加工を適切に行うには前記コイル絶縁層 3 6 が A l 2 O 3 などの無機絶縁材料で形成されていることが必要である。

例えば前記コイル絶縁層 36 が有機絶縁材料で形成された場合、上記の研削加工を施しても前記有機絶縁材料のねばり気によって適切に削り込むことができず平坦化加工を行うことが難しいからである。

【0131】

次に図 27 に示すように、記録媒体との対向面からハイト方向（図示 Y 方向）に所定距離だけ離れた位置に、無機絶縁材料や有機絶縁材料で G d 決め層 38 を形成する。

【0132】

次に図 28 に示す工程では、メッキに必要な例えば N i F e 合金や F e C o 合金から成るメッキシード膜（図示しない）を形成した後、例えば平面形状が図 5 に示す先端部 B と後端部 C とからなるパターン 65 a が設けられたレジスト層 65 を形成し、このパターン 65 a 内に下から下部磁極層 39、ギャップ層 40、上部磁極層 41 及び上部コア層 42 を連続してメッキ形成する。

【0133】

前記下部磁極層 39、ギャップ層 40、上部磁極層 41 及び上部コア層 42 の平面形状は、記録媒体との対向面からハイト方向（図示 Y 方向）に向けて細長形状の先端部 B と、この先端部 B の両側基端 B1 からハイト方向にトラック幅方向（図示 X 方向）が広がる後端部 C とで構成されている。またこのとき前記上部磁極層 41 の前記対向面でのトラック幅方向（図示 X 方向）への幅寸法でトラック幅 T_w が規制される。そして前記レジスト層 65 を除去する。

【0134】

この図 28 工程では、前記下部磁極層 39、ギャップ層 40、上部磁極層 41 及び上部コア層 42 からなる磁極層 62 を、平坦化されたコイル絶縁層 36 上、隆起層 32 上及びバックギャップ層 33 上に形成できる点で効果的である。すなわち前記磁極層 62 を前記コイル絶縁層 36 上、隆起層 32 上及びバックギャップ層 33 上に所定形状に高精度に形成でき、これにより、前記トラック幅 T_w を所定寸法で形成することが可能である。

【0135】

なお本発明では、前記磁極層 62 を下から前記下部磁極層 39、ギャップ層 4

0、上部磁極層 4 1 および上部コア層 4 2 の順に積層して 4 層で形成する場合に限定されるものではなく、例えば前記磁極層 6 2 を下から前記下部磁極層 3 9、前記ギャップ層 4 0、および前記上部磁極層 4 1 の順に積層された 3 層構造で形成しても良い。

【0136】

図 2 8 の工程の次には、図 2 で示す絶縁層 5 8 を形成した後、前記絶縁層 5 8 上から前記接続面 8 1 にかけて第 2 コイル片 5 6 をパターン形成する。この際、第 2 コイル片 5 6 の端部領域 5 6 a、5 6 b が、前記第 1 コイル片 5 5 の端部領域 5 5 a、5 5 b に形成された接続面 8 1 上に直接接するように形成し、両コイル片 5 5、5 6 とを電氣的に接続する。前記第 2 コイル片 5 6 は例えば Cu などの非磁性導電材料でメッキ形成される。また前記第 2 コイル片 5 6 は複数本設けられる。

【0137】

上記した製造方法によれば図 2 3 工程で CMP 技術等を用いて、基準面 A に沿って、コイル絶縁層 3 6、隆起層 3 2 およびバックギャップ層 3 3 の上面を同じ平坦化面として形成され、しかもこの平坦化面に前記接続面 8 1 が露出している。したがって、前記第 2 コイル片 5 6 のトラック幅方向（図示 X 方向）における端部領域 5 6 a、5 6 b を、前記接続面 8 1 を介して前記第 1 コイル片 5 5 の端部領域 5 5 a、5 5 b と直接に接した状態で接続することができる。したがって、前記第 1 コイル片 5 5 と前記第 2 コイル片 5 6 とを、例えば接続層などの介在部材を介さずに、直接に接触した状態で電氣的に接続することができるため、介在部材に起因する電気抵抗が発生しない。

【0138】

なお、前記接続面 8 1 での面積を大きくして前記第 2 コイル片 5 6 との接続を良好にするには、図 2 0 に示す工程で前記第 1 コイル片 5 5 を形成する際、少なくとも前記第 1 コイル片 5 5 の前記持ち上げ層 8 0 上に乗る位置での端部領域 5 5 a、5 5 b の幅寸法を中央領域 5 5 f での幅寸法に比べて大きく形成することが好ましい。また前記持ち上げ層 8 0 上に乗る位置での端部領域 5 5 a、5 5 b の幅寸法を、第 2 コイル片 5 6 の幅寸法より大きくすることが好ましい。

【0139】

また前記接続面 81 の面積は前記接続面 81 上及びコイル絶縁層 36 上に乗る部分での第 2 コイル片 56 の端部領域 56a、56b の下面 56a1、56b1 の面積より小さくてもよいが、小さすぎると電気抵抗が高くなってしまうため、図 23 に示す工程では、前記接続面 81 の面積を、前記接続面 81 上及びコイル絶縁層 36 上に乗る部分での第 2 コイル片 56 の端部領域 56a、56b の下面 56a1、56b1 の面積の 50%～100% の範囲内に形成することが好ましい。

【0140】

図 17 ないし図 28 に示す薄膜磁気ヘッド 1A の製造方法によれば、前記第 1 コイル片 55 の端部領域 55a、55b の下には持ち上げ層 80 を形成し、これによって前記端部領域 55a、55b を中央領域 55f よりも上方に持ち上げるように形成することができるため、第 1 コイル片 55 の上面 55e に前記コイル絶縁層 36 が形成されていても、前記コイル絶縁層 36 を CMP などにより研磨すれば、前記第 2 コイル片 56 との接続面 81 を簡単に露出でき、前記コイル絶縁層 36 にスルーホールを形成する工程が必要ない。仮に、前記コイル絶縁層 36 にスルーホールを形成するものとする、前記スルーホールはエッチング加工により行うことになるが、エッチングでは前記スルーホールを正確な位置や深さで高精度で形成するのは困難であるため、前記スルーホールが形成される位置がずれることによって、前記第 1 コイル片 55 と前記第 2 コイル片 56 との接続面積が小さくなり、電気抵抗が大きくなり、その結果、前記第 1 コイル片 55 と前記第 2 コイル片 56 との接続部で熱が発生するという問題が生じる。また前記スルーホールの形成時に前記第 1 コイル片の端部領域 55a、55b に損傷を与えといった問題もある。

【0141】

これに対し、図 17 ないし図 28 の前記薄膜磁気ヘッド 1A の製造方法では、前記接続面 81 は、持ち上げ層 80 が形成される位置によって決定されるが、この持ち上げ層 80 は、レジストによるフォトリソグラフィによって形成することができるため、容易に、しかも正確な位置に高精度で形成することが可能である。

また、前記コイル絶縁層 36 を CMP 技術などにより研磨する際にその削り量を調整することで、前記接続面 81 を、所定の面積で露出させることができる。そのため、前記第 1 コイル片 55 と前記第 2 コイル片 56 との接続を良好とすることが可能となり、電気抵抗の増大を抑制することができる。

【0142】

さらに、前記下部コア層 29 に凹部を設ける工程が必要がないため、製造が容易であり、また前記下部コア層 29 の断面積を大きくすることができる。したがって、前記下部コア層 29 の磁気飽和を抑制することができ、磁化効率の向上を図ることが可能となる。

【0143】

また本実施の形態のように、下部コア層 29 上に帯状の持ち上げ層 81 を必要な部分にのみ設けることで、接続面 81 以外の部分での第 1 コイル片 55 と第 2 コイル片 56 間の絶縁性や第 1 コイル片 55 や磁極層 62 間の絶縁性はもちろんのこと、前記第 1 コイル片 55 の端面 55c、55d よりも外方領域や各第 1 コイル片 55 間での下部コア層 29 と第 2 コイル片 56 や磁極層 62 との絶縁性も、前記第 1 コイル片 55 の上面 55e を覆うコイル絶縁層 36 により十分な膜厚をもって確保しやすい。

【0144】

また、前記接続面 81 はコイル絶縁層 36 の上面 36a と同一の平坦化面に形成されているため、前記接続面 81 上に第 2 コイル片 56 の端部領域 56a、56b を乗せやすく、前記第 1 コイル片 55 と前記第 2 コイル片 56 との接続を良好にすることができる。したがって、前記第 1 コイル片 55 と前記第 2 コイル片 56 との接触抵抗を更に低く抑えることが可能となる。また前記コイル絶縁層 36 の上面 36a が平坦化面であるので、前記コイル絶縁層 36 上に形成される磁極層 62 を所定形状で形成しやすく、前記磁極層 62 の記録媒体との対向面での幅寸法で決定されるトラック幅 Tw を高精度に形成できる。

【0145】

なお、図 19 に示す工程では、図 4 に示す実施の形態のように、前記持ち上げ層 80 を所定の幅寸法で実質的にハイト方向に延びる帯状の形状で形成しても良

いが、本発明はこれに限定されるものではなく、図19に示す工程で、図6に示すように、前記持ち上げ層80を複数の持ち上げ片80aによって分断形成し、前記持ち上げ片80aが各第1コイル片55の端部領域55a、55bを、それぞれ上方に持ち上げるように形成しても良い。

【0146】

薄膜磁気ヘッド1Bを製造するには、図19で示す工程で、図8に示す持ち上げ層80を形成し、図21に示す工程で、前記第1コイル片55の端部55c、55dが前記持ち上げ層80の表面の途中まで形成することによって製造することができる。

【0147】

図21に示す工程で、前記第1コイル片55の端部55c、55dを前記持ち上げ層80の表面の途中まで形成すると、前記したレベリング効果を抑制できるため、前記持ち上げ層80上に前記端部領域55a、55bを厚い膜厚で形成できる。この結果、前記接続面81を前記コイル絶縁層36内に埋没している前記第1コイル片55の上面55eに比べて十分に上方に持ち上げることができ、前記第1コイル片55の上面55eと前記磁極層62間の絶縁性などを十分に確保しやすくなる。

【0148】

なお、図19に示す工程では、図8に示す実施の形態のように、前記持ち上げ層80を所定の幅寸法で実質的にハイト方向に延びる帯状の形状で形成しても良いが、本発明はこれに限定されるものではなく、図19に示す工程で、図9に示すように、前記持ち上げ層80を複数の持ち上げ片80aによって分断形成し、前記持ち上げ片80aが各第1コイル片55の端部領域55a、55bを、それぞれ上方に持ち上げるように形成しても良い。

【0149】

薄膜磁気ヘッド1Cを製造するには、図19で示す工程で、図11、図12、に示す持ち上げ層180、280を形成し、図21に示す工程で、前記第1コイル片55の端部55c、55dが前記持ち上げ層180の表面の途中まで形成することによって製造することができる。

【0150】

図19で示す工程で、前記持ち上げ層180は、図10に示すように、X-Z平面と平行な方向での断面形状が所定の高さ寸法 h_2 を有した略台形状に形成され、前記持ち上げ層180の上面180bには平坦化面が形成される。前記第1コイル片55の端部領域55a、55bは、前記持ち上げ層180の表面の途中まで形成され、第1コイル片55のトラック幅方向における端部55c、55dが、平坦化された前記上面180bの上に位置するように形成される。

【0151】

前記持ち上げ層180の上面180bは平坦化面に形成されるため、前記上面180bの上に形成される前記第1コイル片55の端部領域55a、55bは厚さ寸法 t_1 が大きく形成されやすい。すなわち、前記持ち上げ層180の上面180bに前記第1コイル片55はフレームメッキ法により形成されるが、このとき、前記持ち上げ層180の上面180bが平坦化面に構成されていると、前記第1コイル片55が、図20に示すZ方向にメッキ成長しやすくなり、前記膜厚 t_1 を大きくすることが可能になるのである。前記膜厚 t_1 が大きく構成されると、前記接続面181の面積を所定面積に画定しやすいとともに、第1コイル片55と磁極層62間のコイル絶縁層36の膜厚を厚くできるので、前記第1コイル片55と磁極層62間の絶縁性を良好に保ちやすい。

【0152】

ただし、前記第1コイル片55の両側端面55c、55dは前記持ち上げ層180の上面180bの途中にあることが好ましく、仮に図2のように前記両側端面55c、55dをトラック幅方向にて前記持ち上げ層180の外方にまで延出形成すると、レベリング効果が発生しやすく、前記持ち上げ層180の上面180aに乗る部分での持ち上げ層180の膜厚 t_1 が小さくなりやすい。よって前記レベリング効果を抑制するには、前記第1コイル片55を前記持ち上げ層180の上面180bの途中までしか形成しないようにすることが好ましい。

【0153】

なお上記のレベリング効果は、前記上面180bが平坦化面として形成されている持ち上げ層180の前記上面180bに、第1コイル片55を乗り上げ形成

した場合の方が、表面が湾曲面である持ち上げ層、たとえば図2に示す前記持ち上げ層80上に、第1コイル片55を乗り上げ形成する場合に比べて大きいものと考えられる。このため表面が湾曲面である持ち上げ層80を用いる場合は、図2のように前記持ち上げ層80を越えて、その外方にまで前記第1コイル片55を延出形成しても、レベリング効果は、上面180bが平坦化面として形成される前記持ち上げ層180を用い、前記持ち上げ層180を超えてその外方にまで第1コイル片55を延出形成する場合に比べて小さいものと考えられる。

【0154】

図19に示す工程では、図11に示す実施の形態のように、前記持ち上げ層180を所定の幅寸法で実質的にハイト方向に延びる帯状の形状で形成しても良いが、本発明はこれに限定されるものではなく、図19に示す工程で、図12に示すように、前記持ち上げ層180は複数の持ち上げ片180aによって分断形成され、前記持ち上げ片180aが各第1コイル片55の端部領域55a, 55bを、それぞれ上方に持ち上げるように形成しても良い。図11に示すように、帯状に延びる一体の持ち上げ層180が複数の各第1コイル片55の端部領域55a, 55bの下を横断するように形成すると、前記持ち上げ層180の製造が容易になる。

【0155】

また、図12のように前記持ち上げ層180を個々の持ち上げ片180aに分断し、各持ち上げ片180a上にそれぞれの第1コイル片55の端部領域55a, 55bを形成すると、前記持ち上げ片180a間に空間ができるので、この部分にコイル絶縁層36を厚い膜厚で形成でき、隣り合う第1コイル片55の端部領域55a, 55b間の絶縁性を良好に保つことができる。

【0156】

薄膜磁気ヘッド1Dを製造するには、図19で示す工程で、図14に示す持ち上げ片280aを形成し、図21に示す工程で、前記第1コイル片55の端部55c, 55dが前記持ち上げ片280aの上面に位置するように形成することによって製造することができる。

【0157】

なお、図19に示す工程で、図15に示すように、端部領域55a、55bの幅寸法w1より前記持ち上げ片280aの直径dが小さくなるように形成すると、前記持ち上げ片280a上に乗る端部領域55a、55bは少なくなるため、前記コイル絶縁層36の上面36aから露出する接続面281の面積も減少してしまう。このため、前記接続面281の面積を大きくして、第2コイル片56と第1コイル片55との接続を確実なものにするには、図19で示す工程で、図16に示すように、持ち上げ片280aの直径dが前記端部領域55a、55bの幅寸法W1よりも大きくなるように形成した方がよい。ただしレベリング効果を少なくするには、図15に示すように、端部領域55a、55bの幅寸法W1より、前記持ち上げ片280aの直径dが小さくなるように前記持ち上げ片280aを形成した方が好ましいと考えられる。

【0158】

以上、本発明における薄膜磁気ヘッドは、例えばハードディスク装置などに搭載される磁気ヘッド装置に内蔵される。前記薄膜磁気ヘッドは浮上式磁気ヘッドあるいは接触式磁気ヘッドのどちらに内蔵されたものでもよい。また前記薄膜磁気ヘッドはハードディスク装置以外にも磁気センサ等に使用できる。

【0159】

【発明の効果】

以上詳述した本発明の薄膜磁気ヘッドは、第1コイル片の第2コイル片との接続面を前記第1コイル片上を覆うコイル絶縁層上から露出させ、露出した前記接続面上に直接、前記第2コイル片を接合しているので、接続層などの介在部材やスルーホールなどの形成が必要なく、簡単に且つ確実に両コイル片の電氣的な接続を行うことができるとともに、電気抵抗を低くすることができる。従って第1コイル片と第2コイル片とで構成されるトロイダルコイル構造から出る熱を従来に比べて少なくでき、前記薄膜磁気ヘッド内部での温度の上昇を抑制でき、熱膨張による薄膜磁気ヘッドの突出量を小さくすることができる。

【0160】

また、下部コア層に凹部を設ける必要がないため、前記下部コア層の断面積を大きくすることができる。したがって、前記下部コア層の磁気飽和を抑制するこ

とができ、磁化効率の向上を図ることが可能となる。

【0161】

また、本発明の薄膜磁気ヘッドの製造方法によれば、コイル絶縁層を研磨することにより、前記コイル絶縁層の上面に第1コイル片に形成された接続面を簡単に露出できるため、接続面を容易に、しかも正確な位置に高精度で形成することが可能である。また、前記コイル絶縁層を研磨する際にその削り量を調整することで、前記接続面を所定の面積で露出させることができるため、前記第1コイル片と前記第2コイル片との接続を良好とすることが可能となり、電気抵抗の増大を抑制することができる。したがって、製造された薄膜磁気ヘッドは、内部での温度が高温になることによる熱膨張量を小さくでき、薄膜磁気ヘッドおよび記録媒体の損傷を防止できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明における第1の実施の形態の薄膜磁気ヘッドの構造を示す縦断面図、

【図2】

図1に示す薄膜磁気ヘッドの部分正面図、

【図3】

図1に示す薄膜磁気ヘッドの第1コイル片と第2コイル片および磁極層の構造を示す部分平面図、

【図4】

図1に示す薄膜磁気ヘッドの第1コイル片および磁極層の構造を示す部分平面図、

【図5】

図1に示す薄膜磁気ヘッドの部分拡大斜視図、

【図6】

図1に示す薄膜磁気ヘッドの第1コイル片および磁極層の他の構造を示す部分平面図、

【図7】

本発明における第2の実施の形態の薄膜磁気ヘッドの構造を示す部分正面図、

【図 8】

図 7 に示す薄膜磁気ヘッドの第 1 コイル片および磁極層の構造を示す部分平面図、

【図 9】

図 7 に示す薄膜磁気ヘッドの第 1 コイル片および磁極層の他の構造を示す部分平面図、

【図 10】

本発明における第 3 の実施の形態の薄膜磁気ヘッドの構造を示す部分正面図、

【図 11】

図 10 に示す薄膜磁気ヘッドの第 1 コイル片および磁極層の構造を示す部分平面図、

【図 12】

図 10 に示す薄膜磁気ヘッドの第 1 コイル片および磁極層の他の構造を示す部分平面図、

【図 13】

本発明における第 4 の実施の形態の薄膜磁気ヘッドの構造を示す部分正面図、

【図 14】

図 13 に示す薄膜磁気ヘッドの第 1 コイル片および磁極層の構造を示す部分平面図、

【図 15】

図 13 に示す薄膜磁気ヘッドの第 1 コイル片および突出片の構造を示す部分拡大平面図、

【図 16】

図 13 に示す薄膜磁気ヘッドの第 1 コイル片および突出片の他の構造を示す部分拡大平面図、

【図 17】

図 1 に示す薄膜磁気ヘッドの製造方法を示す一工程図、

【図 18】

図 17 に示す工程の次に行われる一工程図、

【図 1 9】

図 1 8 に示す工程の次に行われる一工程図、

【図 2 0】

図 1 9 に示す工程の次に行われる一工程図、

【図 2 1】

図 1 9 に示す工程の次に行われる一工程図、

【図 2 2】

図 2 0 および図 2 1 に示す工程の次に行われる一工程図、

【図 2 3】

図 2 2 に示す工程の次に行われる一工程図、

【図 2 4】

図 2 2 に示す工程の次に行われる他の一工程図、

【図 2 5】

図 2 3 に示す工程が終了した時点の状態を示した部分縦断面図、

【図 2 6】

図 2 3 に示す工程が終了した時点の状態を示した部分正面図、

【図 2 7】

図 2 3 に示す工程の次に行われる一工程図、

【図 2 8】

図 2 5 に示す工程の次に行われる一工程図、

【図 2 9】

従来の薄膜磁気ヘッドの構造を示す部分正面図、

【符号の説明】

1 A, 1 B, 1 C, 1 D 薄膜磁気ヘッド

2 0 基板

2 2 下部シールド層

2 3 下部ギャップ層

2 4 磁気抵抗効果素子

2 9 下部コア層

3 2 隆起層

3 3 バックギャップ層

3 6 コイル絶縁層

5 5 第 1 コイル片

5 5 a, 5 5 b 端部領域

5 5 c、5 5 d 端面

5 6 第 2 コイル片

5 6 a, 5 6 b 端部領域

5 8 絶縁層

6 2 磁極層

8 0, 1 8 0, 2 8 0 持ち上げ層

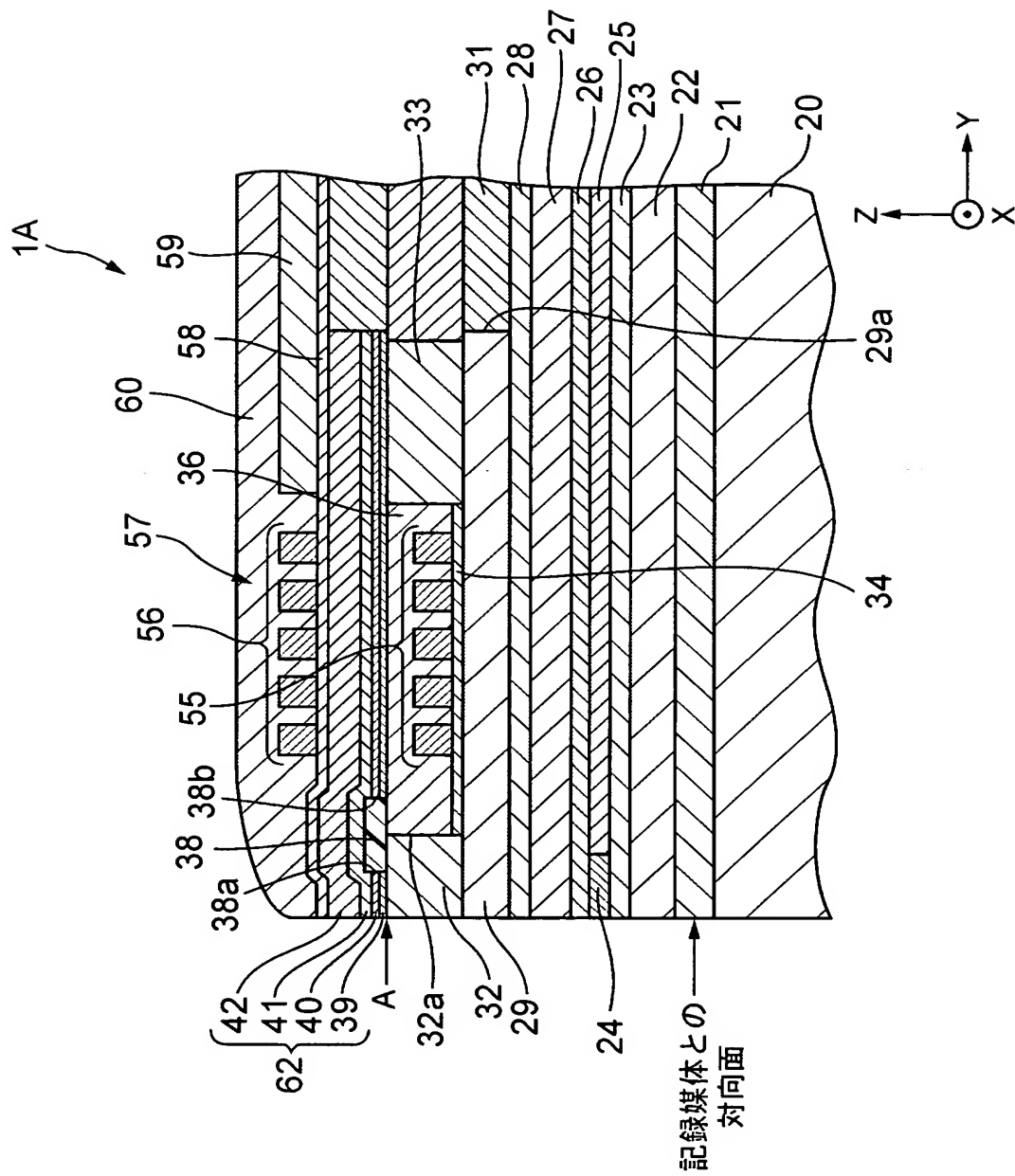
8 0 a, 1 8 0 a, 2 8 0 a 持ち上げ片

8 1, 1 8 1, 2 8 1 接続面

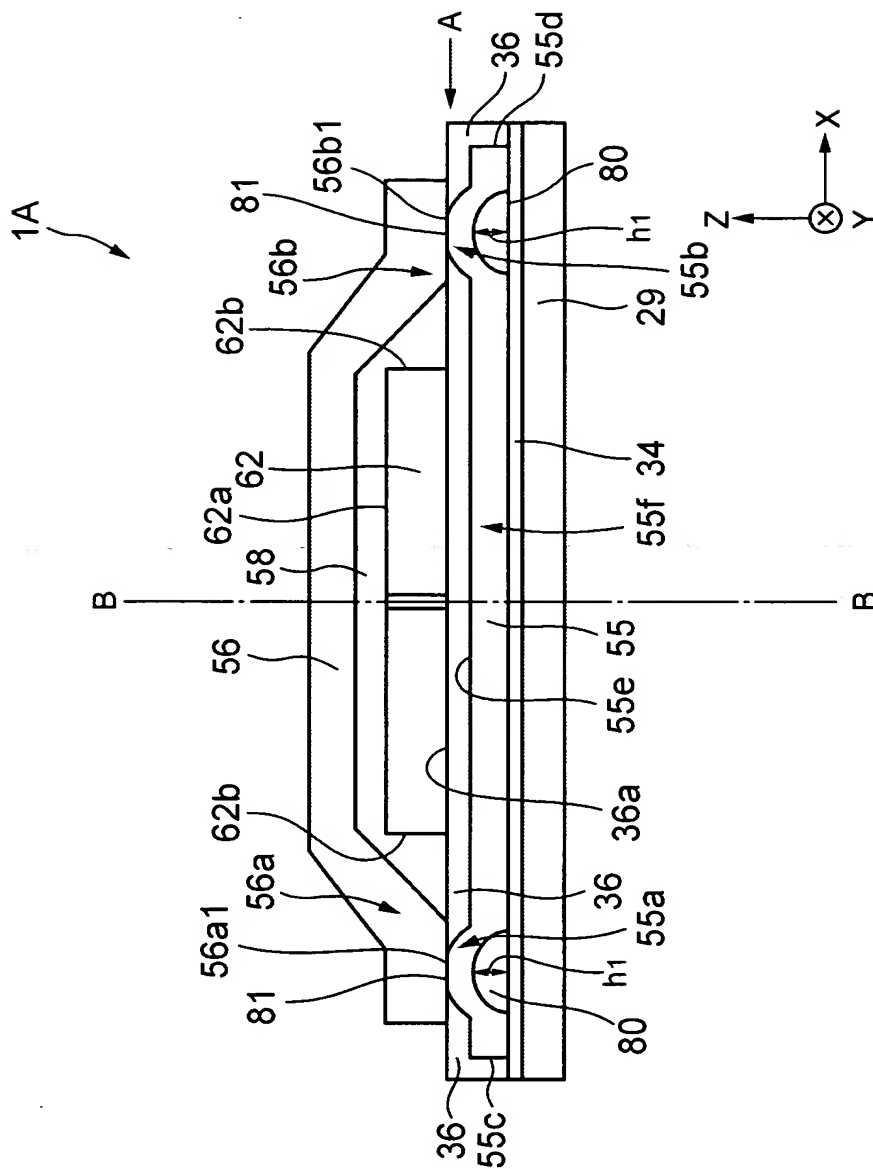
【書類名】

図面

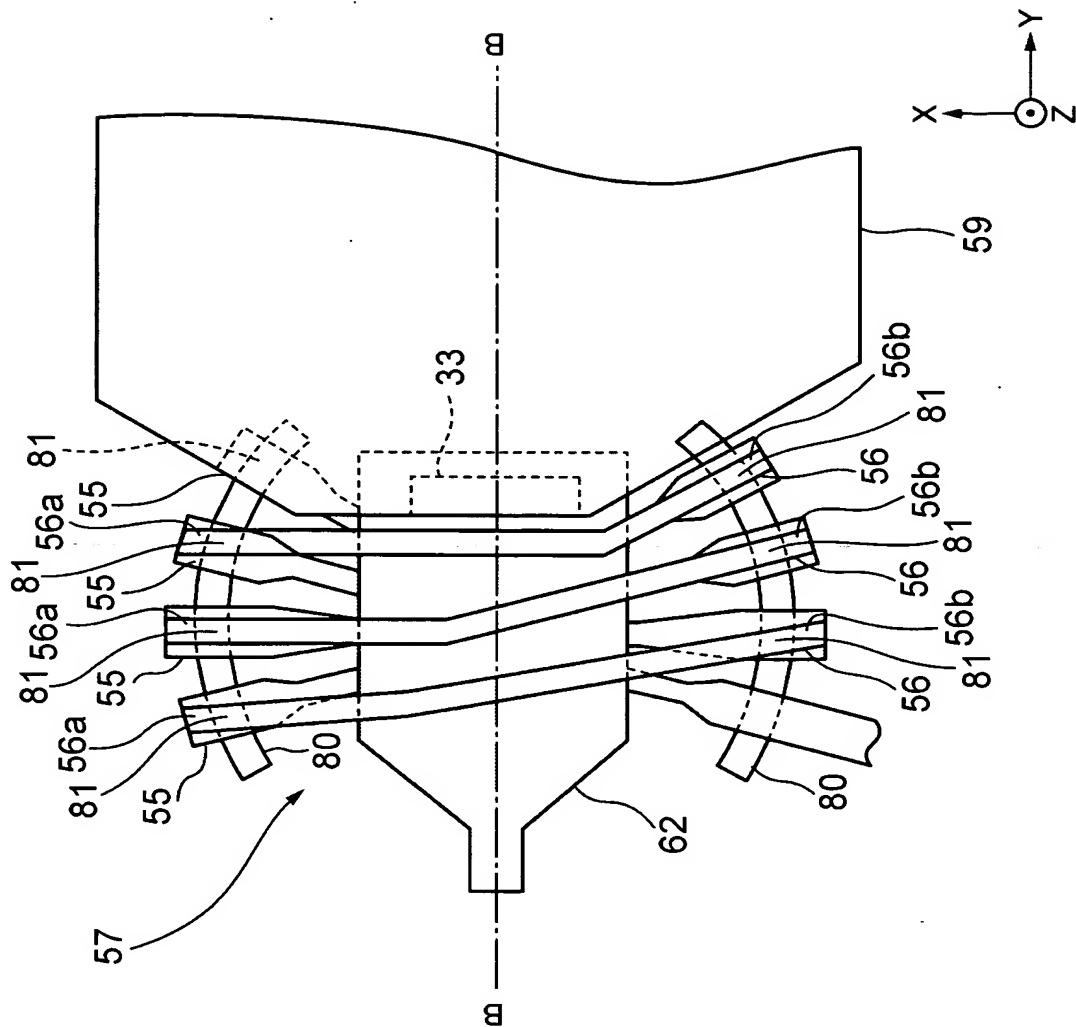
【図 1】



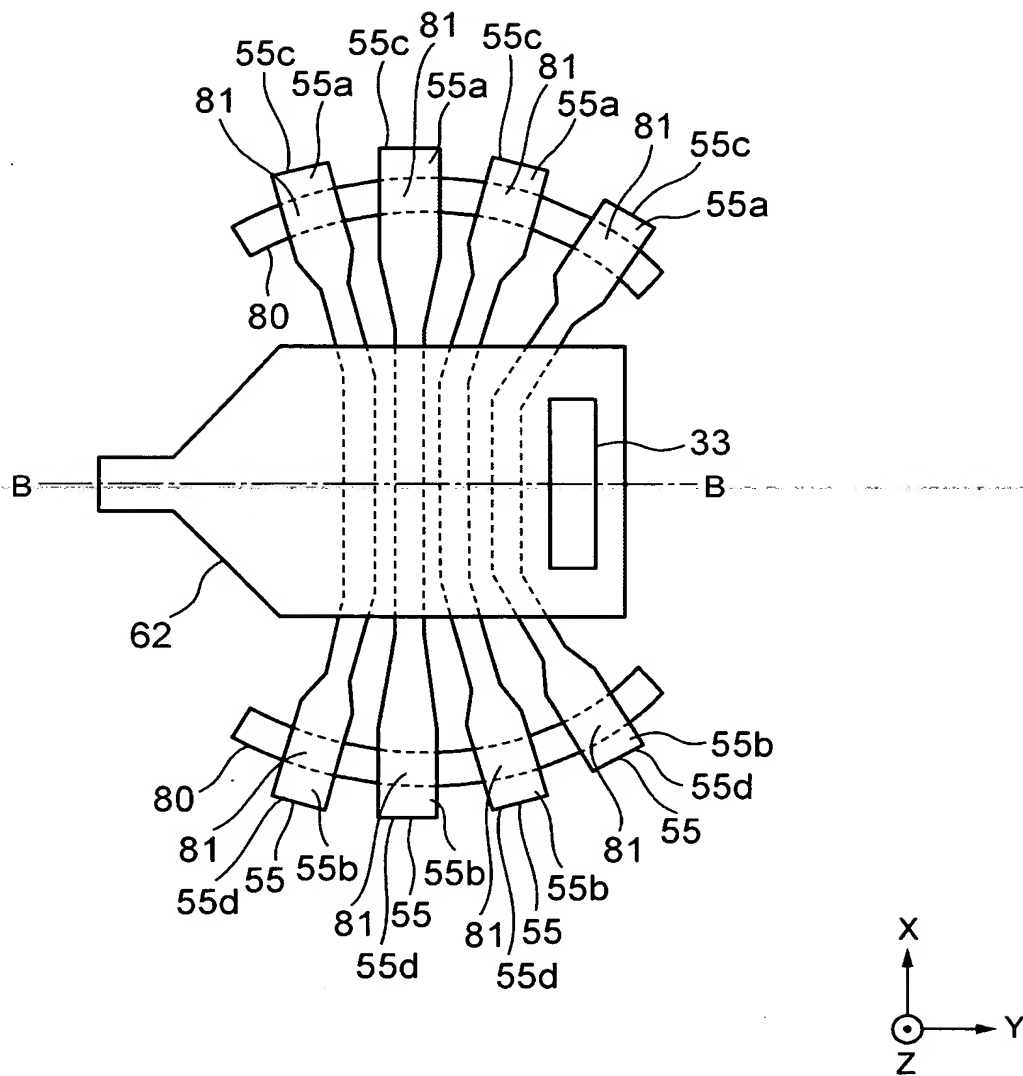
【図 2】



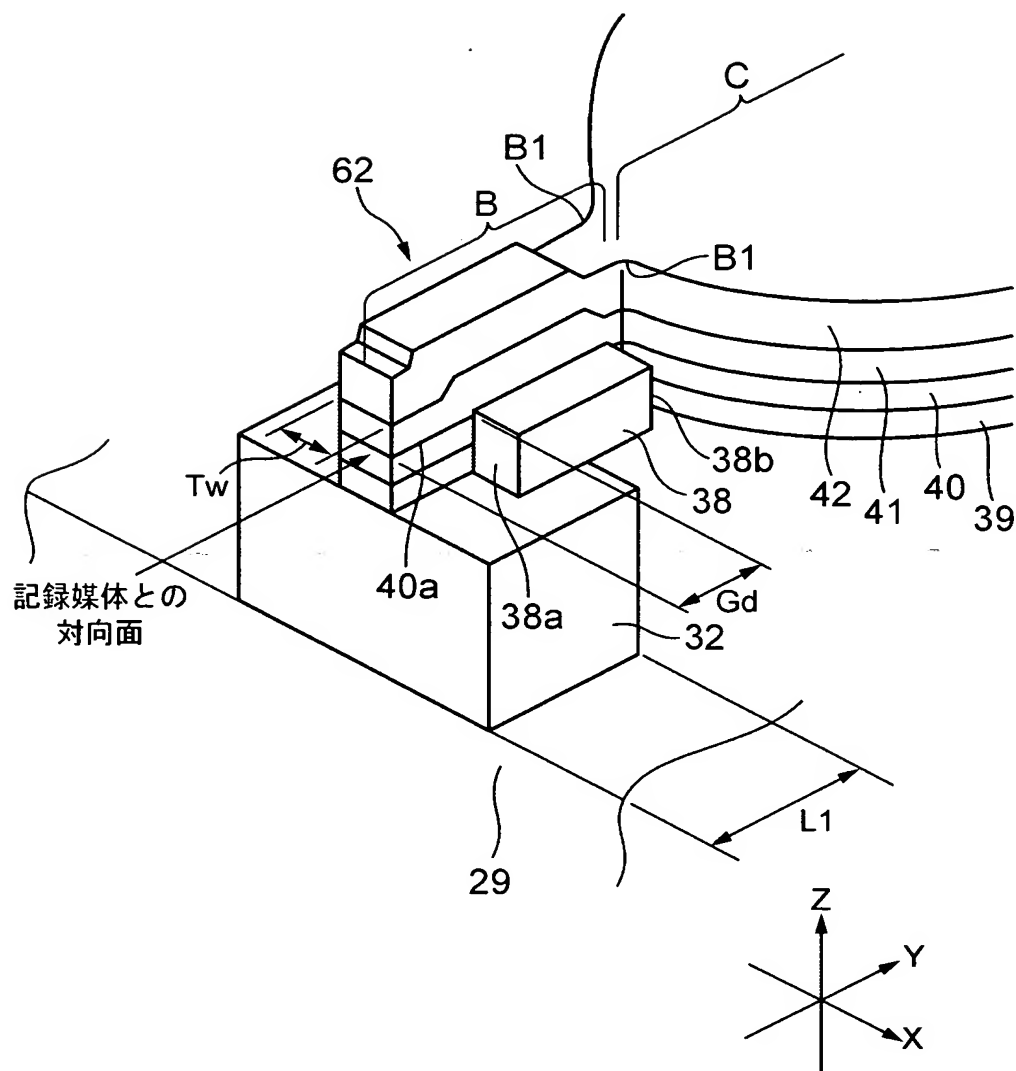
【図 3】



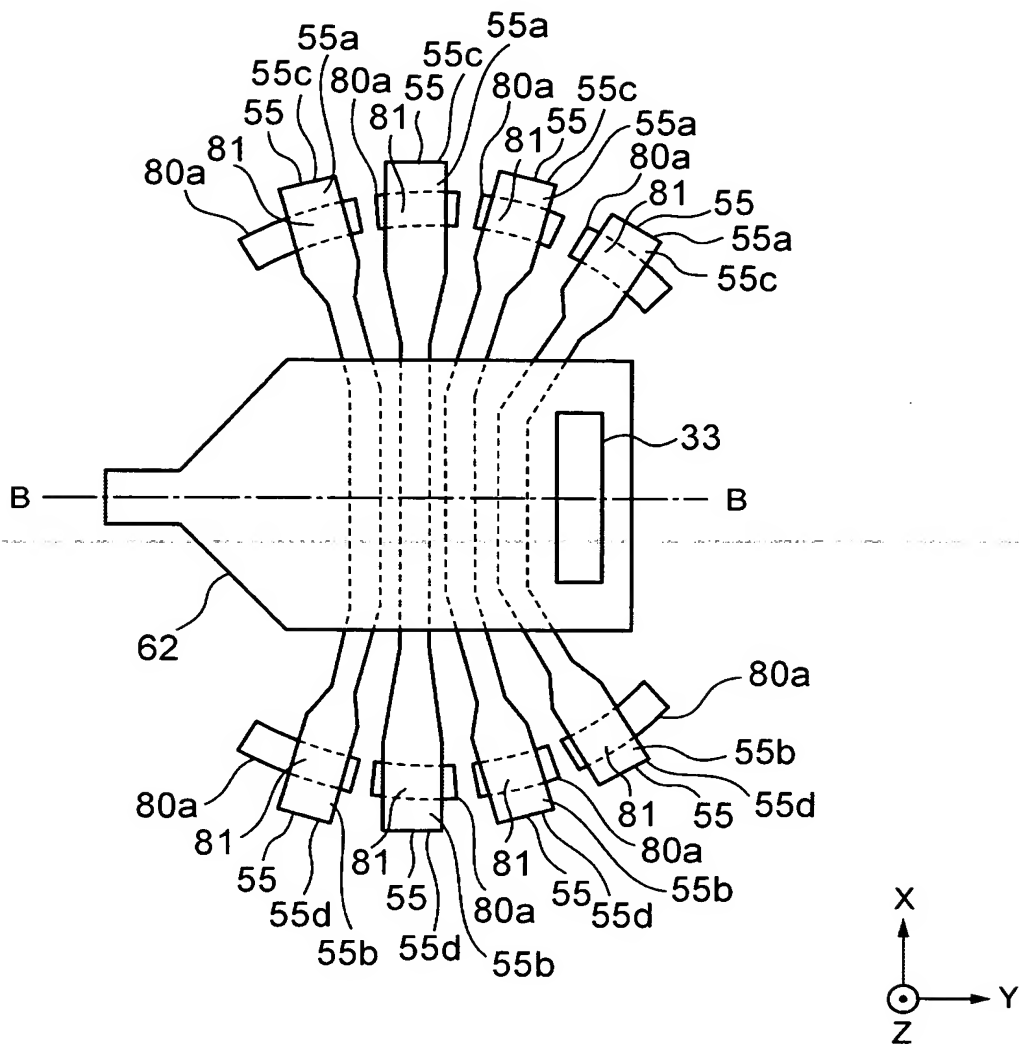
【図 4】



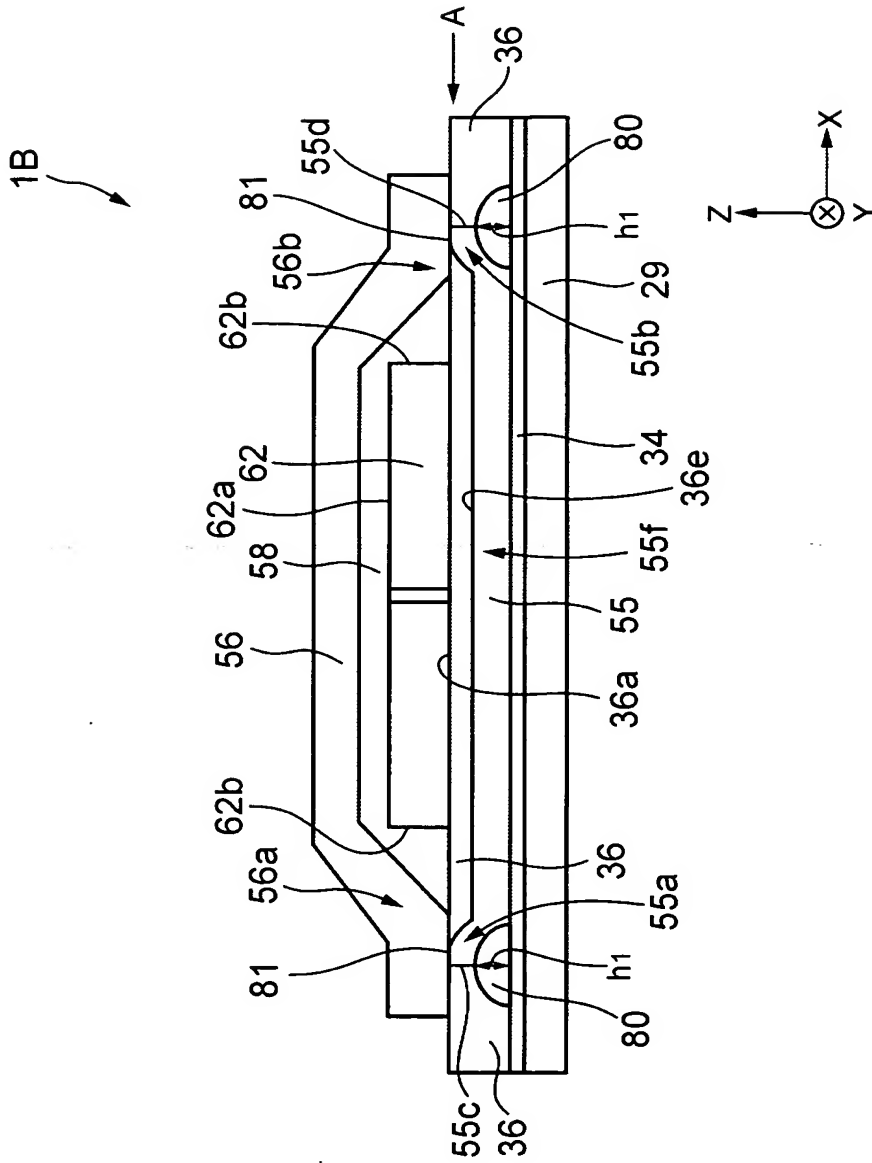
【図 5】



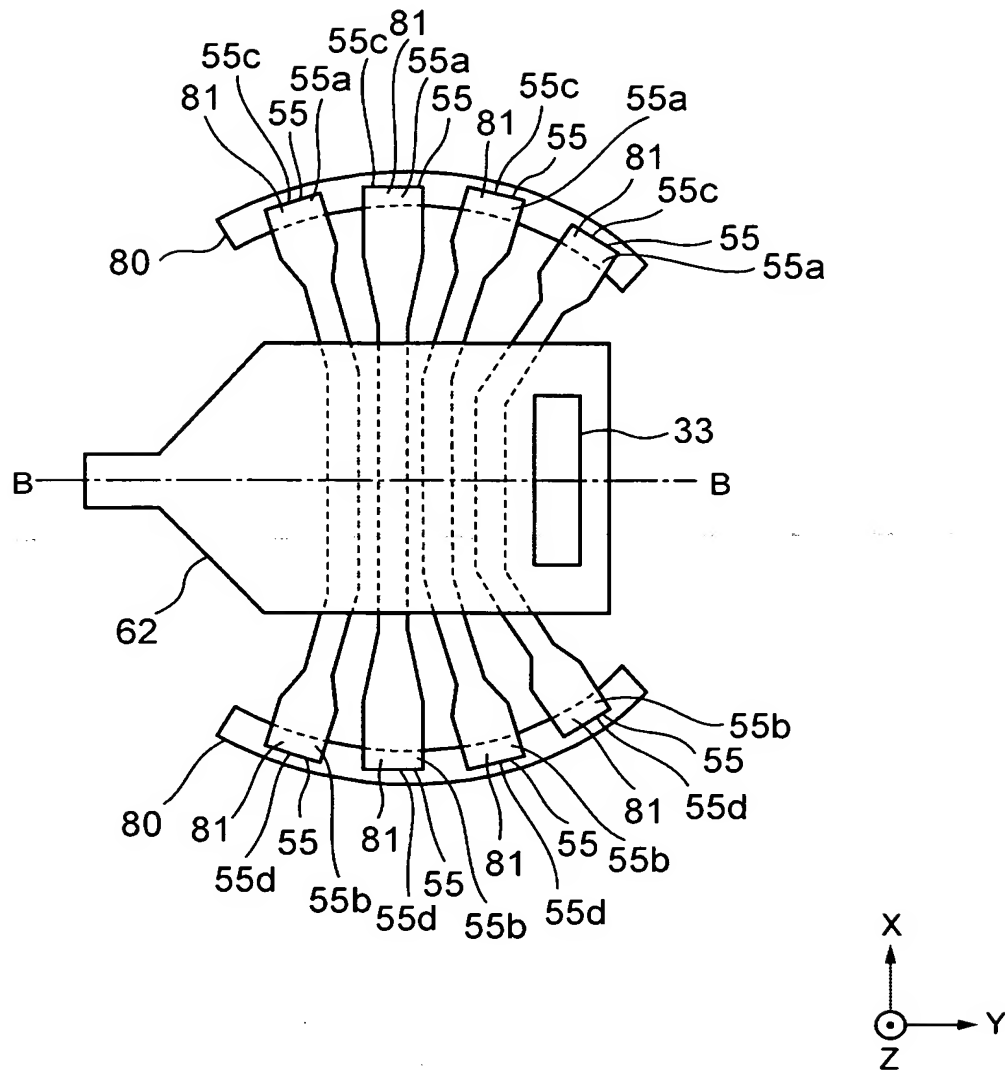
【図 6】



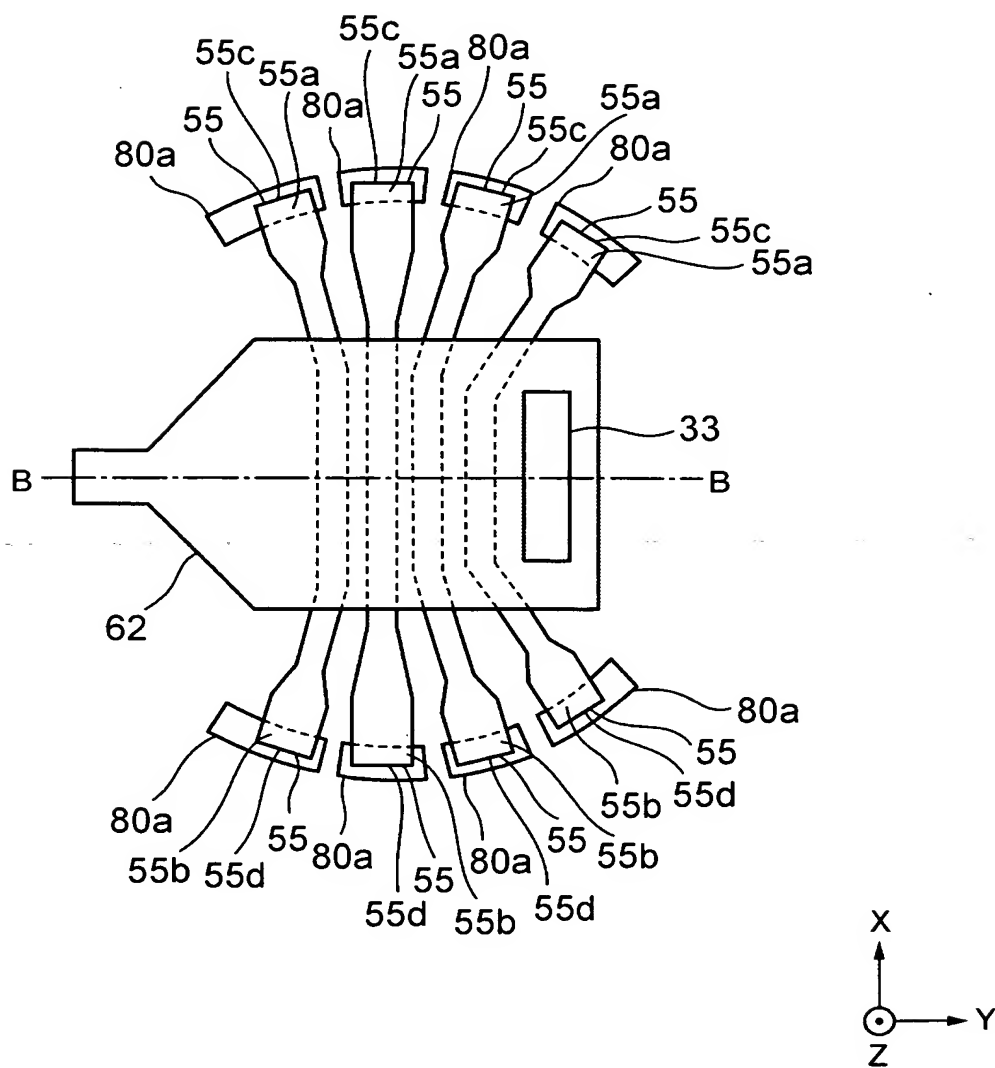
【図 7】



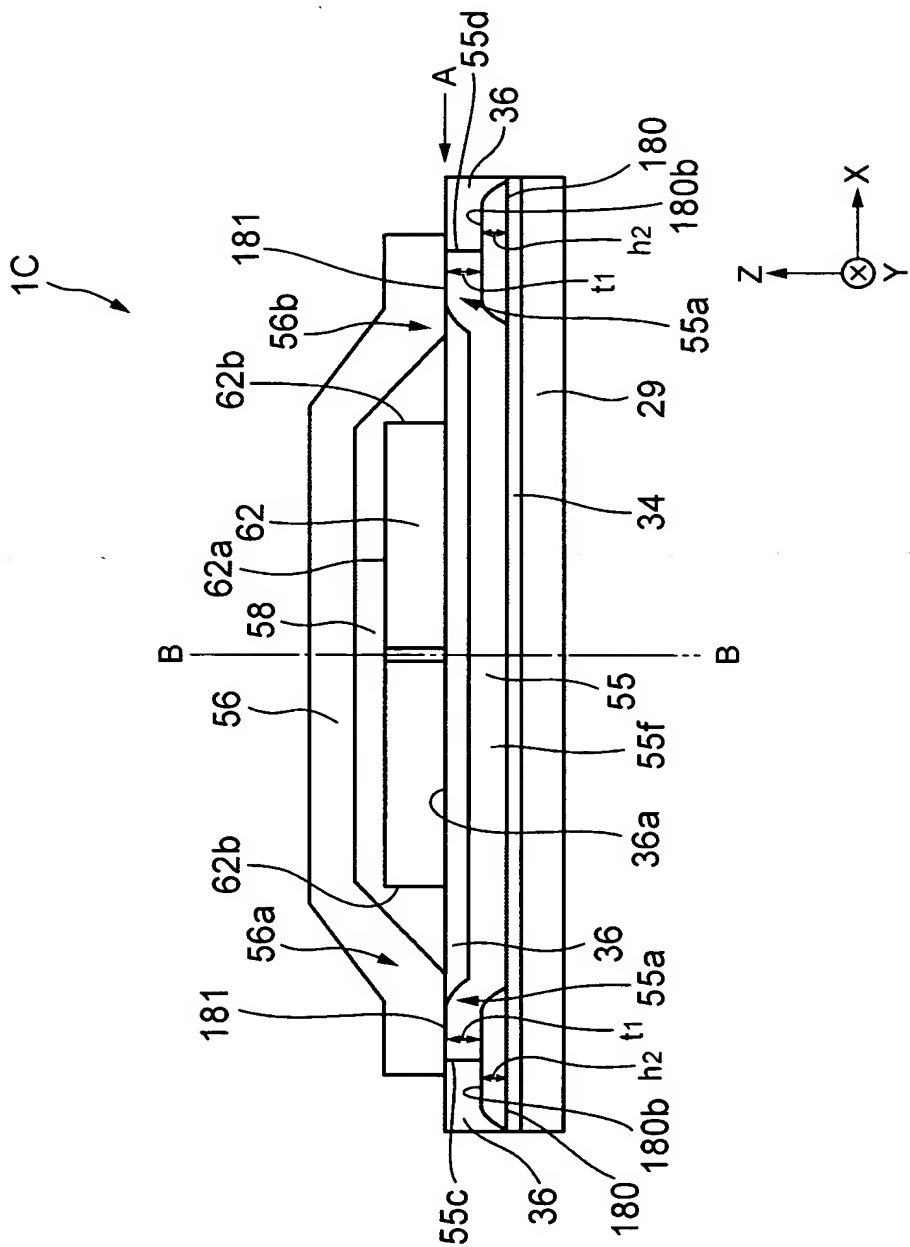
【図 8】



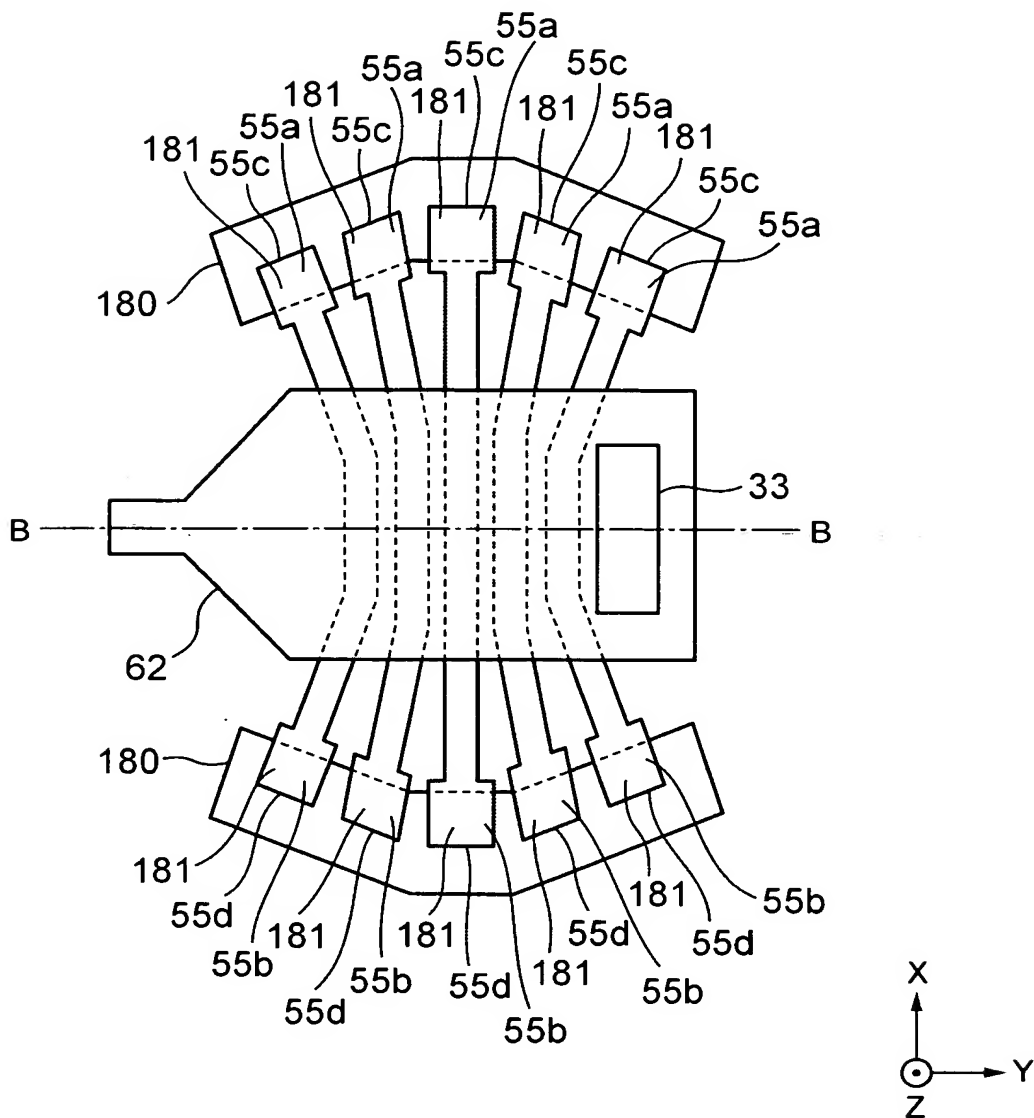
【図 9】



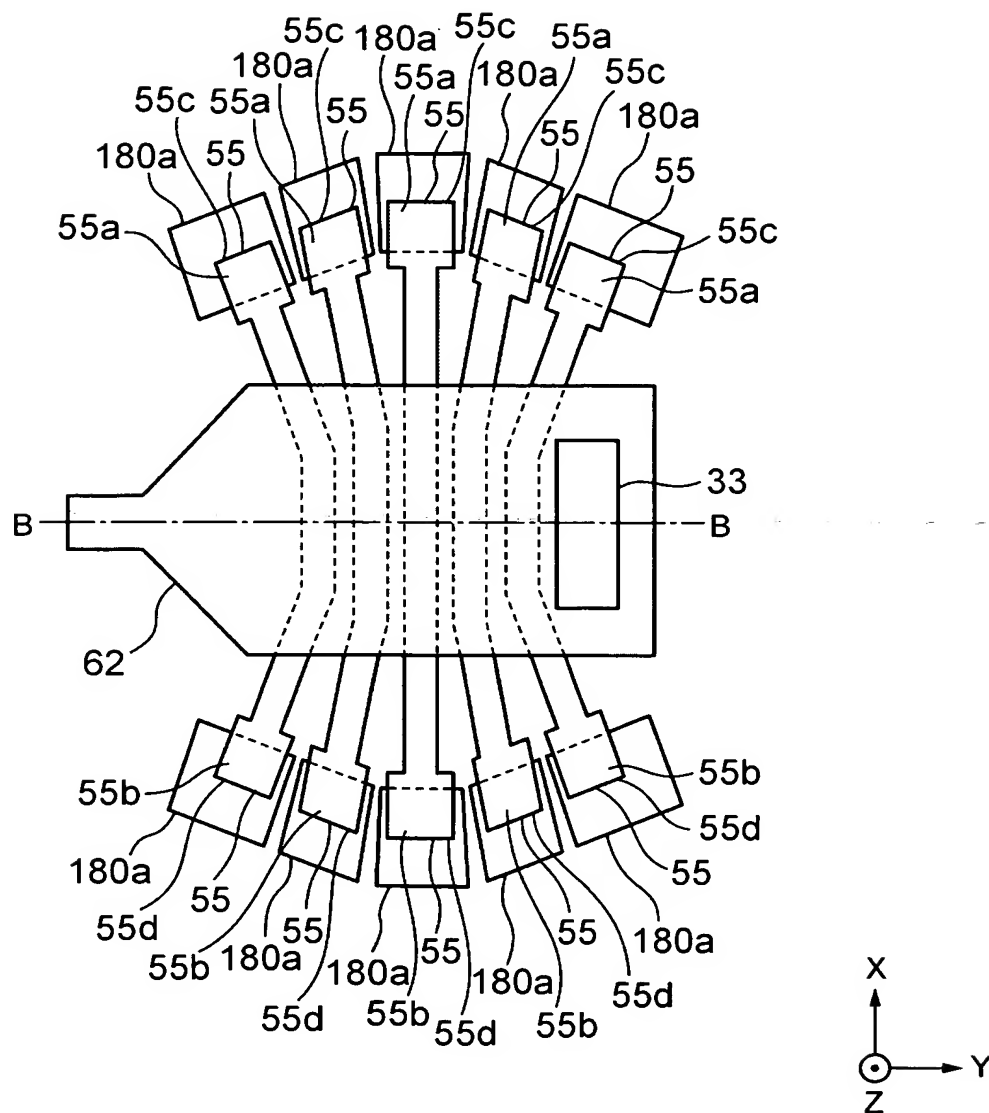
【図 10】



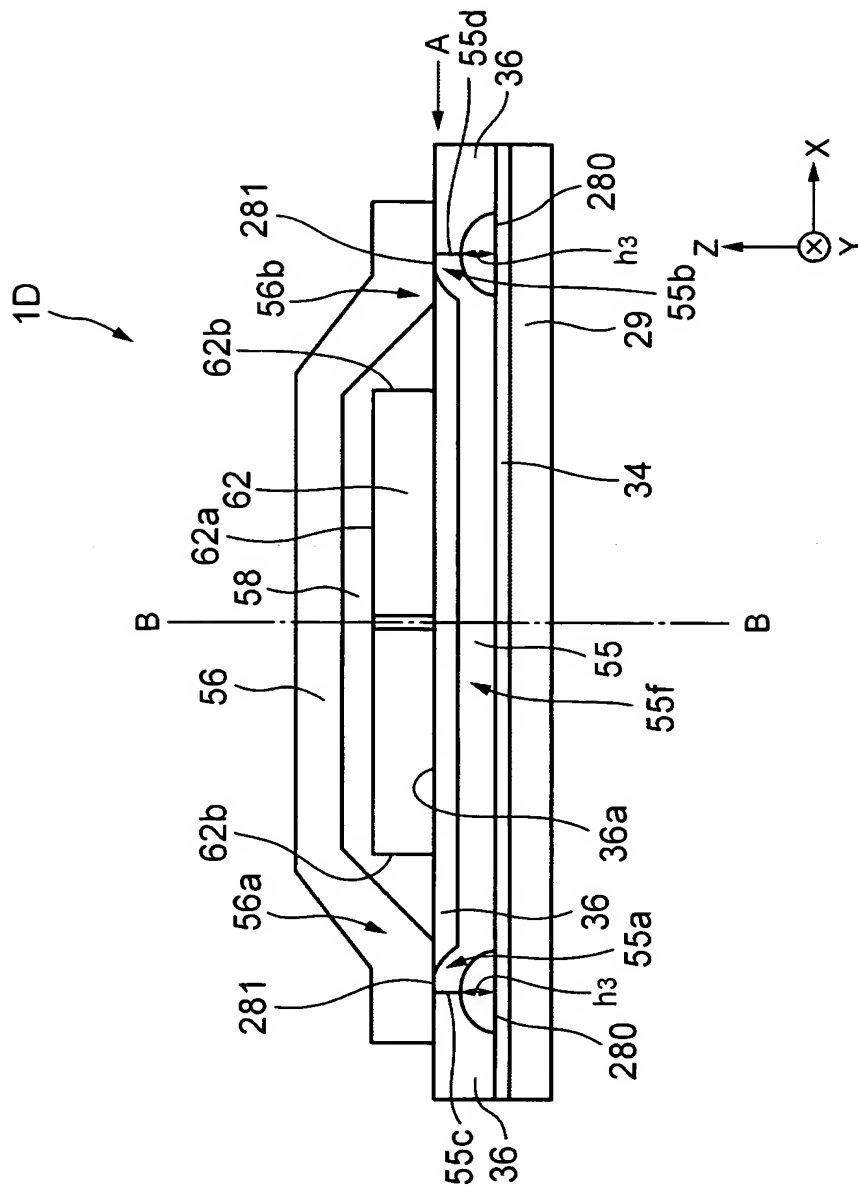
【図 11】



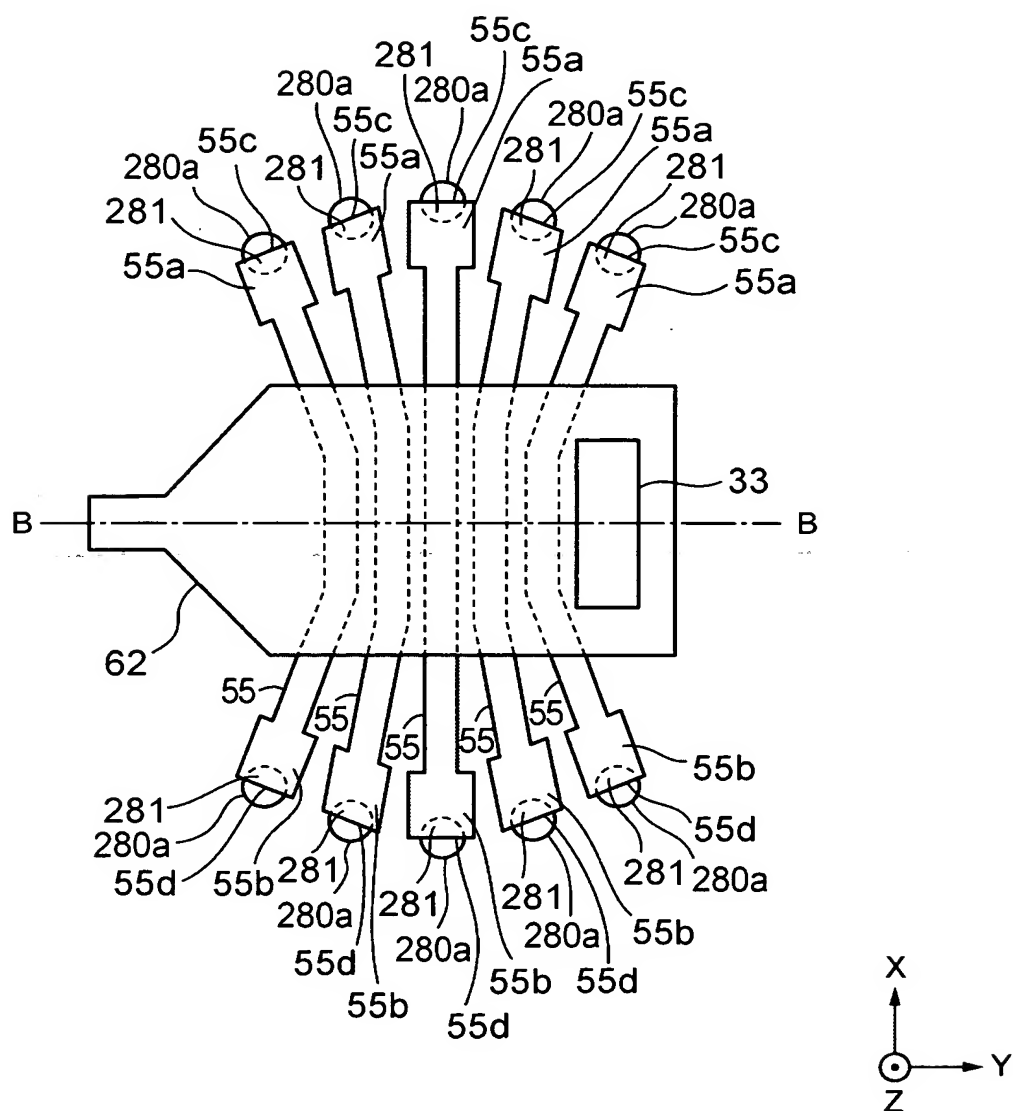
【図 12】



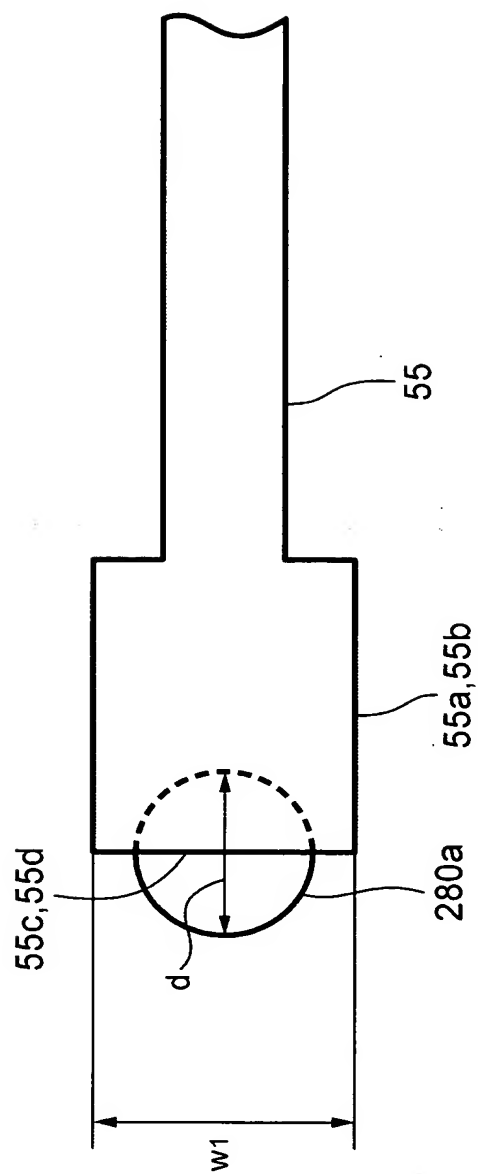
【図 13】



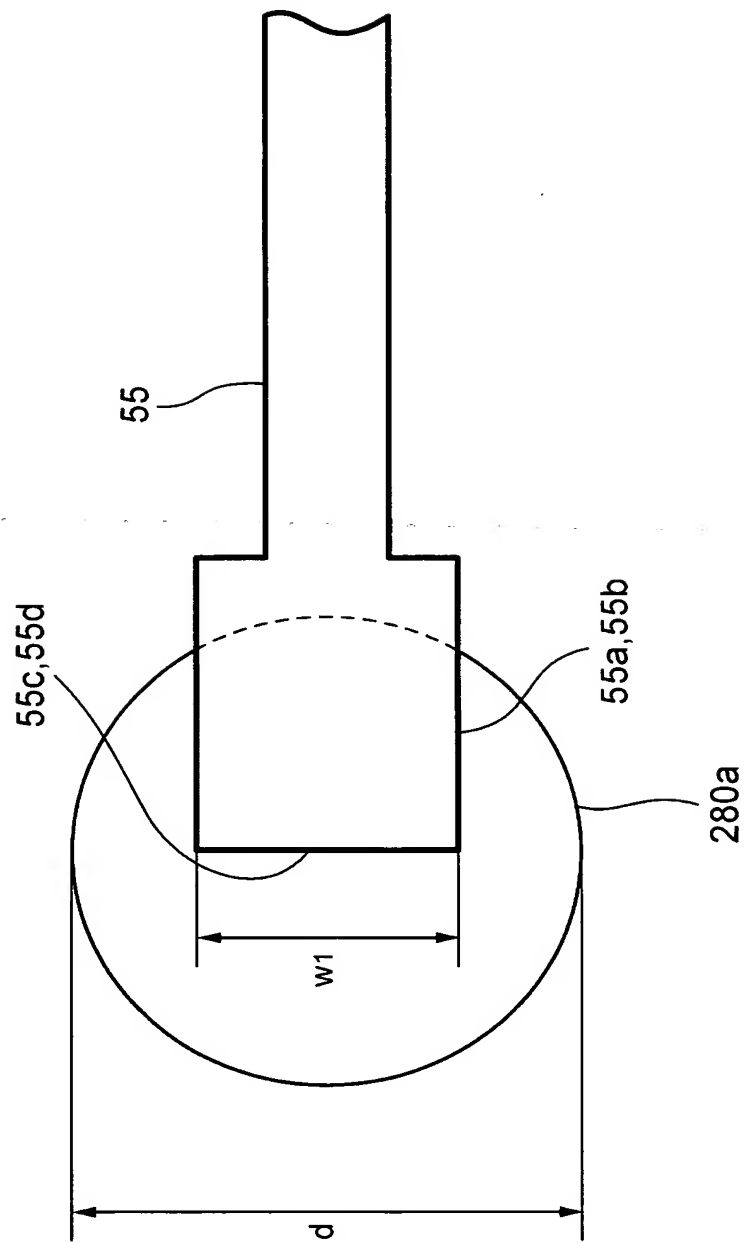
【図 14】



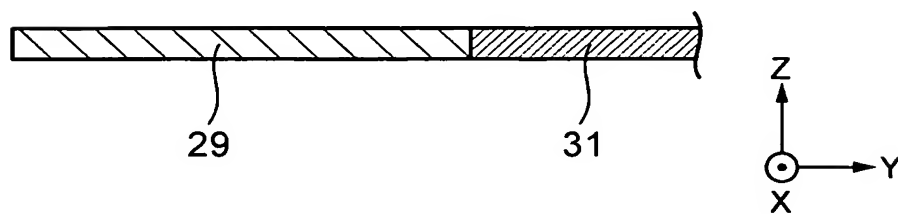
【図 15】



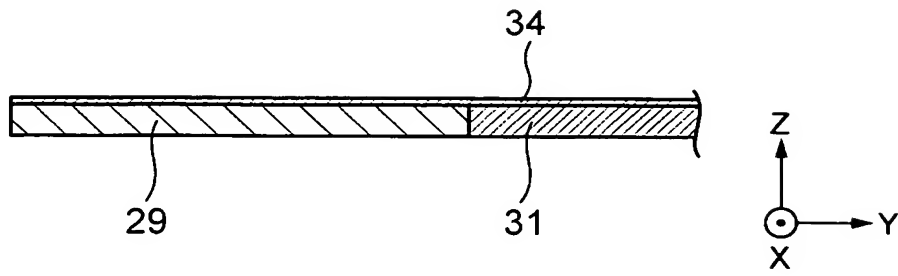
【図 16】



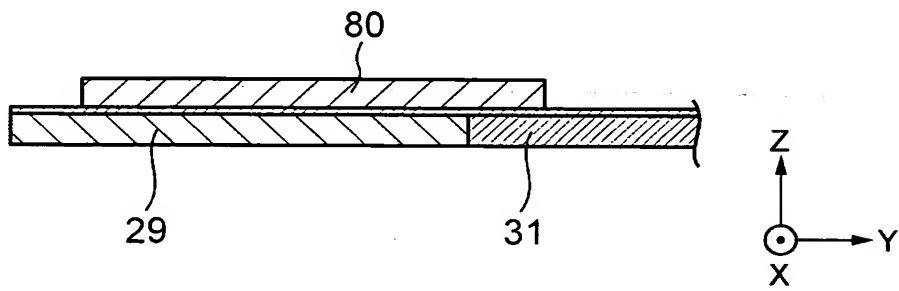
【図 17】



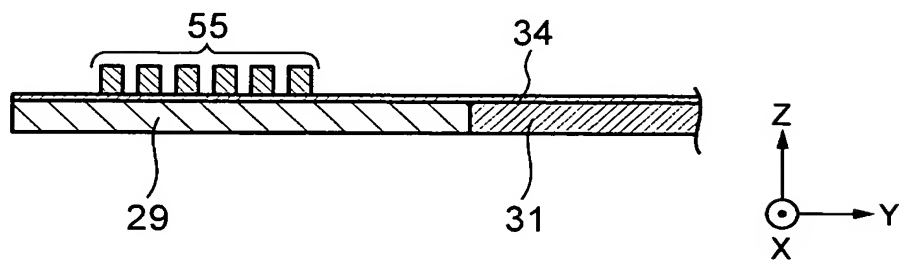
【図 18】



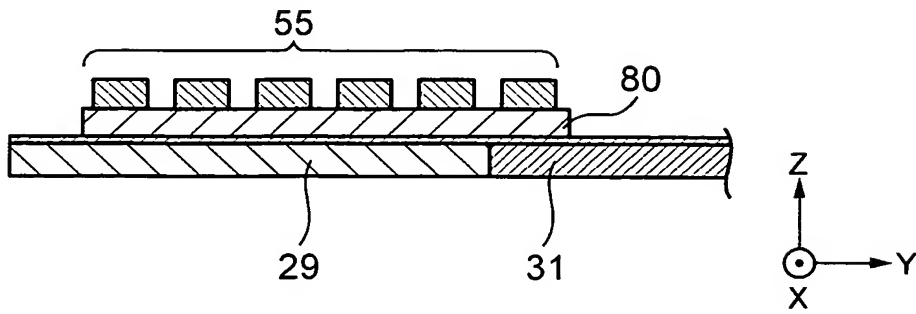
【図 19】



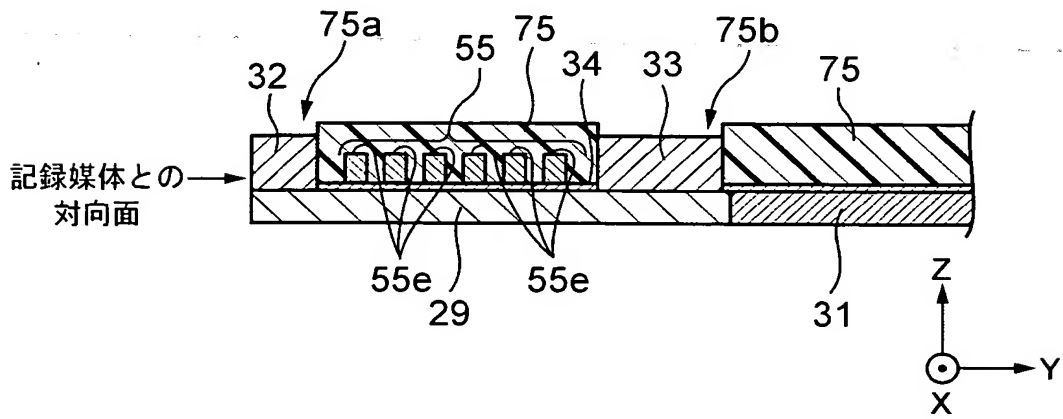
【図 20】



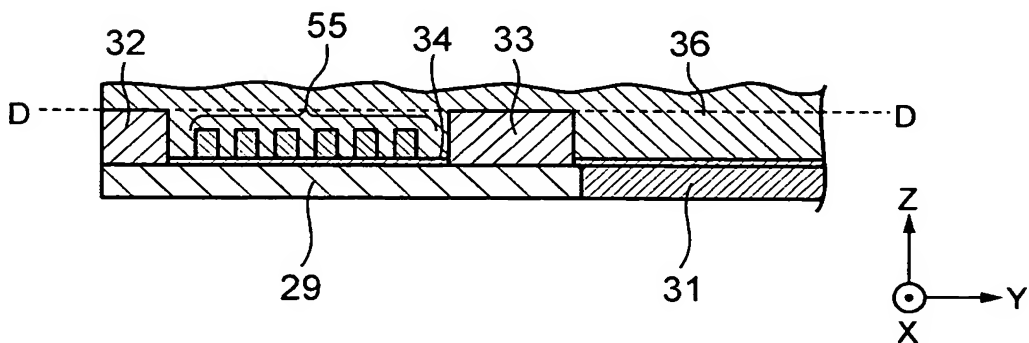
【図 2 1】



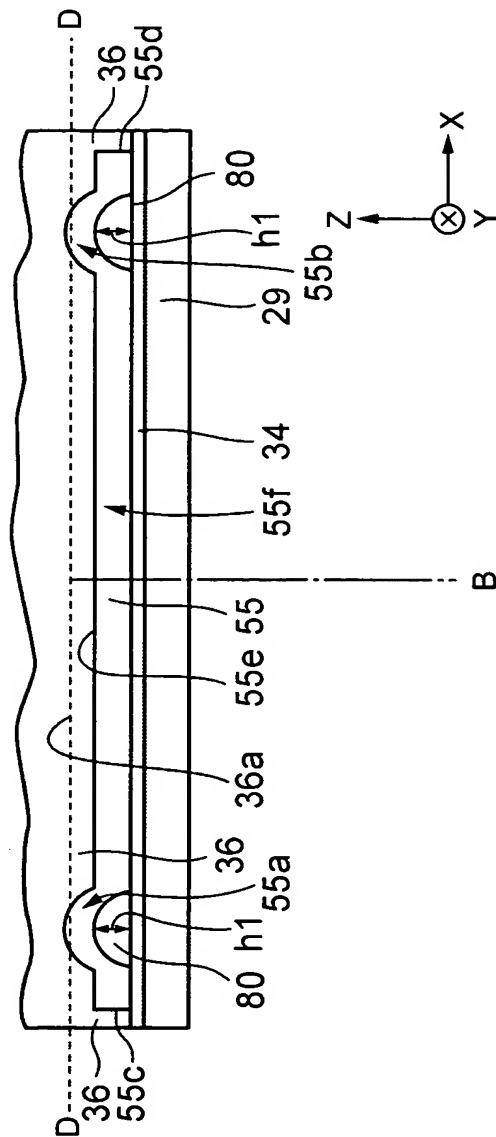
【図 2 2】



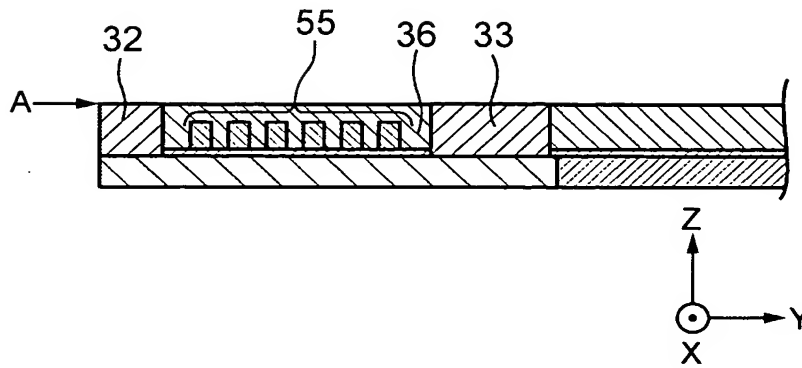
【図 2 3】



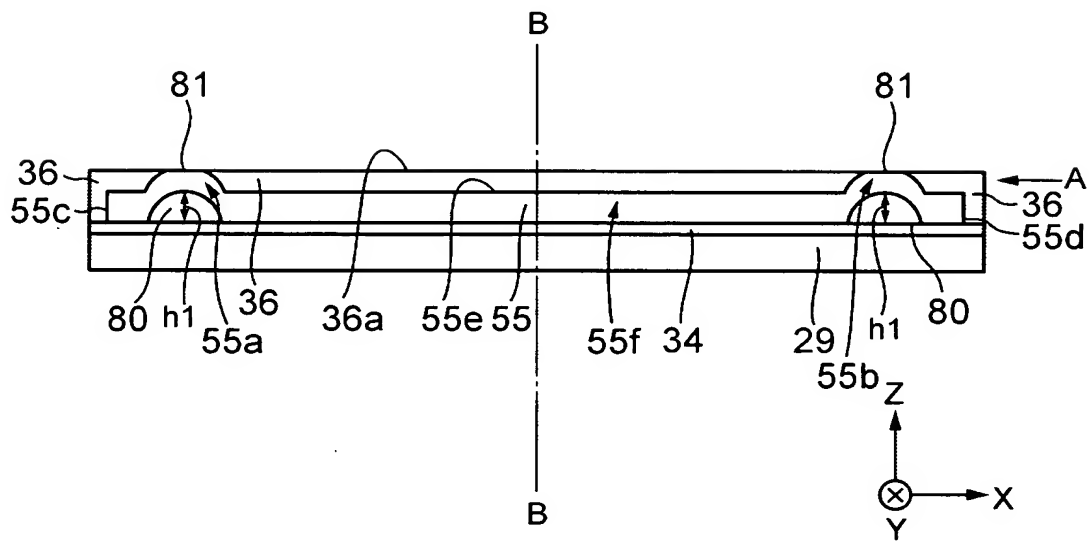
【図 2 4】



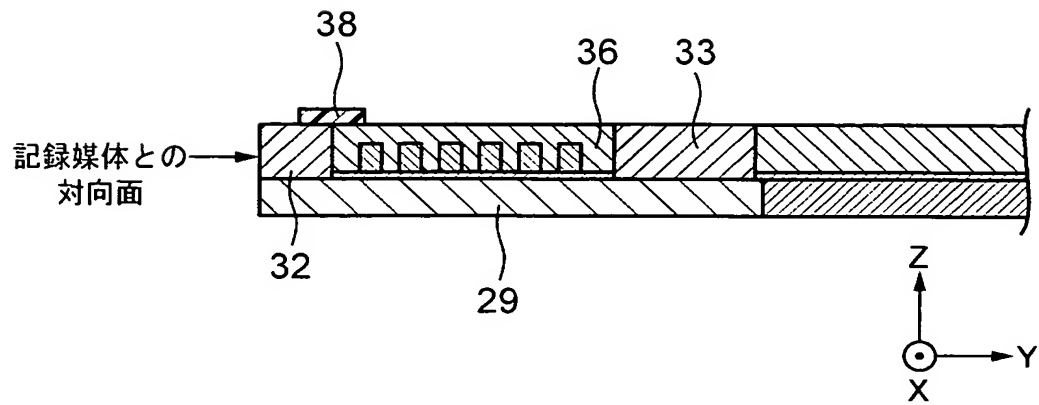
【図 25】



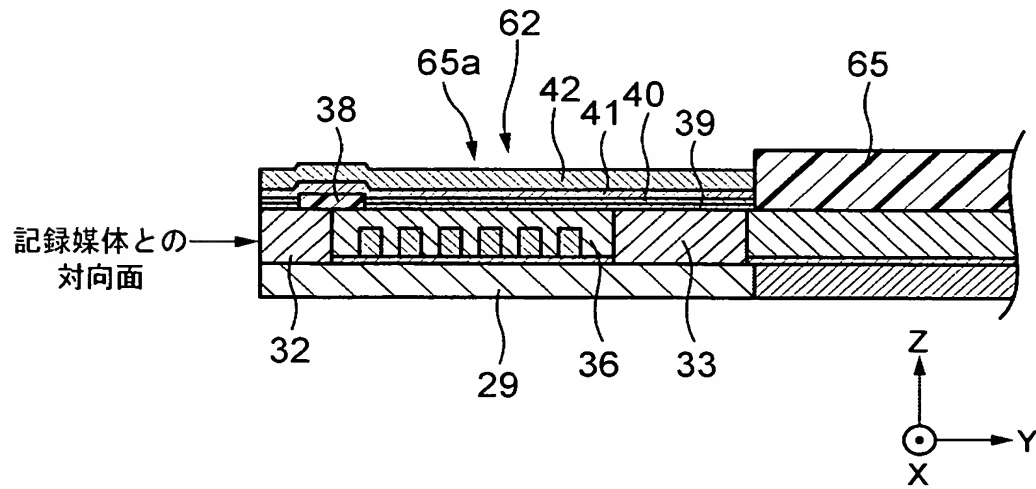
【図 26】



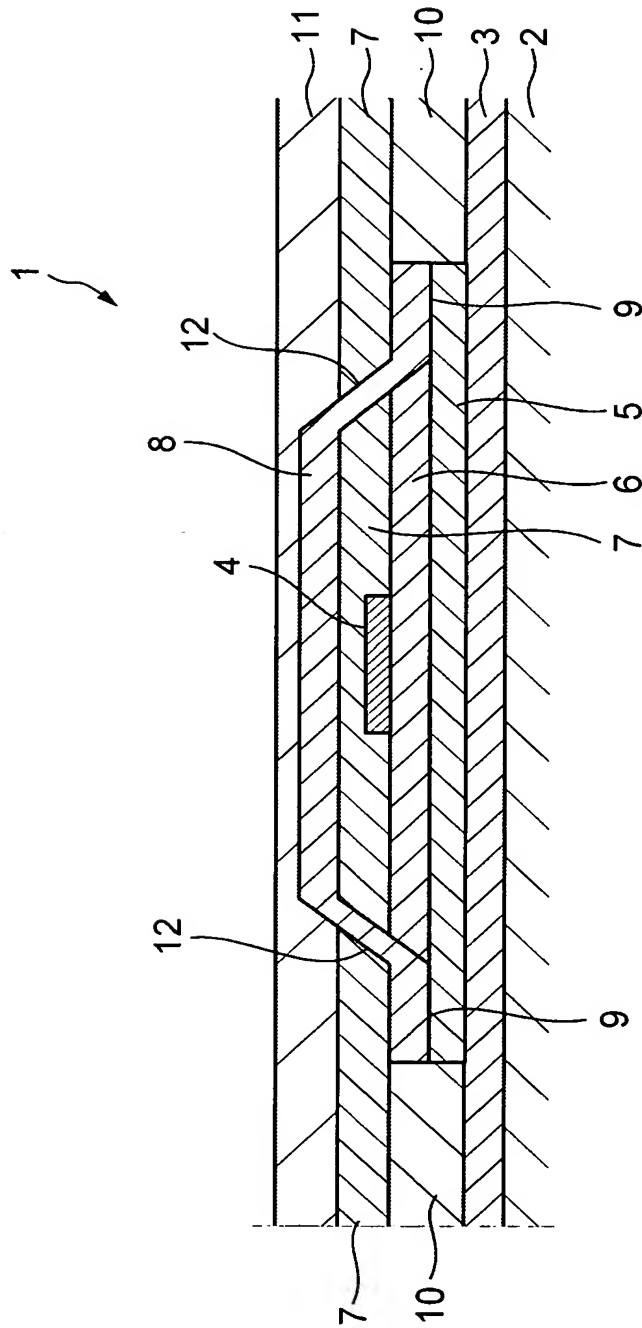
【図 27】



【図 28】



【図 29】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 第1コイル片と第2コイル片との接続抵抗を小さくできるとともに磁気飽和し難く、磁化効率の向上が可能な薄膜磁気ヘッドを提供する。

【解決手段】 下部コア層29、隆起層32及びバックギャップ層33で囲まれた空間内に、コイル絶縁層36で覆われた複数本の第1コイル片55がハイト方向に並んで形成されている。前記コイル絶縁層36上、隆起層32上及びバックギャップ層33上に形成された磁極層62上に、絶縁層58を介して複数本の第2コイル片56がハイト方向に並んで形成されている。前記下部コア層29と前記第1コイル片55との間には持ち上げ層80が形成されており、前記第1コイル片と前記第2コイル片とは前記持ち上げ層80の上方でコイル絶縁層36から露出した接続面81において接触している。

【選択図】 図2

特願 2 0 0 3 - 0 6 9 3 3 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 1 0 0 9 8]

1 . 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号

氏 名

アルプス電気株式会社